

臺灣新竹地方法院 裁判書 -- 民事類

【裁判字號】 93,重智,3

【裁判日期】 991231

【裁判案由】 損害賠償

【裁判全文】

臺灣新竹地方法院民事判決

93 年度重智字第 3 號

原 告

即反訴被告 美商應用材料股份有限公司(Applied Materials,
Inc.)

法定代理人 Michael

訴訟代理人 林怡芳律師(僅受本訴之委任)

複代理人 童啓哲

訴訟代理人 賴中強律師(僅受本訴之委任)

複代理人 李貞儀律師(僅受本訴之委任)

反訴被告 美商業凱科技股份有限公司

法定代理人 郭怡之

上列二人共同

訴訟代理人 林秋琴律師

上列二人共同

訴訟代理人 陳彥希律師

上列二人共同

訴訟代理人 林哲誠律師

上列二人共同

訴訟代理人 陳長蕙律師

被 告

即反訴原告 韓商周星工程股份有限公司 (Jusung Enginerrin
g CO., Ltd)

四十九 (#49,Neungpycong-Ri,Opo-E
up,Kwangju-Gun,Kyunggi-Do,Korea
464-892

法定代理人 Chul-ju,

四十九(Chul-ju, Hwang)

訴訟代理人 張哲倫律師

訴訟代理人 樓穎智專利代理人

被 告

即反訴原告 英屬蓋曼群島商周星科技股份有限公司
號二樓

法定代理人 李泳坤

號二樓

上列二人共同

訴訟代理人 黃章典律師

上列當事人間損害賠償事件，本院於民國 99 年 12 月 1 日辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由反訴原告負擔。

事實及理由

壹、程序部分：

1. 管轄權及準據法：

本件本訴原告即反訴被告美商應用材料股份有限公司

(Applied Materials, Inc. 號以下簡稱美商應材公司) 係美商，本訴被告即反訴原告韓商周星工程股份有限公司 (

Jusung Enginerring CO., Ltd. 以下簡稱韓商周星工程公司

) 係韓商、英屬蓋曼群島商周星科技股份有限公司(以下簡稱英屬開曼群島商周星科技公司) 係英屬開曼群島商，均為

為外國法人，具有涉外因素，本訴原告其主張本訴被告侵害其專利權應負擔損害賠償責任，反訴原告主張反訴被告違反

公平交易法、侵權行為，應負損害賠償責任，均應適用涉外民事法律適用法，定本件之管轄法院及準據法。按因侵權行為

為涉訟者，得由行為地之法院管轄，為民事訴訟法第 15 條第 1 項所

規定。涉外民事法律適用法雖未就法院之管轄予以規定，惟本訴被告英屬開曼群島商周星科技公司亦設於本院轄區，反訴原告主張反訴被告之侵權行為地亦在我國，因此依

國際民事訴訟管轄之以原就被原則或類推適用我國民事訴訟法第 15 條第 1 項規定，我國法院對本侵權事件應有管轄權。

本院就此涉外之專利侵權事件及反訴事件有管轄權。被告主張就本件侵害專利權之訴訟，因原告不能證明被告在我國境內有侵害專利權行為，是以我國法院應無管轄權，顯有誤會。

次按，關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之。侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限，涉外民事法律適用法第 9 條定有明文，故關於涉外侵權行為之準據法，應適用「侵權行為地」及「法庭地法」，依上開規定

，

本件涉外事件之準據法，自應適用中華民國之法律。

2. 就被告韓商周星工程公司所提出相關產品文件及圖說，本院業已於民國(下同)99年4月21日核發秘密保持命令，故就原告、被告關於侵權之陳述、本院對是否侵權之判斷，因涉及該秘密保持命令客體之營業秘密，故另以密封方式附於本判決，就該部分僅該受秘密保持命令裁定者始得檢閱，合先敘明。

貳、本訴部分：

(一)、聲明：

1. 被告不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口「型號 EUREKA 6000」之「供液晶顯示器用之電漿輔助化學氣相沈積設備」(以下間稱系爭產品)及其他侵害原告所有中華民國發明第 152996 號專利之電漿輔助化學氣相沈積設備。
2. 被告應連帶給付原告新台幣(下同)178,200,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之 5 計算之利息。
3. 訴訟費用由被告負擔。
4. 原告願供擔保請准宣告假執行。

(二)、陳述：

1. 緣原告為全球知名的半導體、平面顯示器與液晶顯示器製程設備與服務供應商，在台灣擁有數百項與半導體、平面顯示器與液晶顯示器製程及設備相關之物品及方法專利。其中包括中華民國經濟部智慧財產局專利證書發明第 152996 號，發明名稱為「電漿室中以可彎曲方式懸固之氣體散流組件」，專利期間為 2002 年 3 月 1 日至 2021 年 1 月 15 日之發明專利(原證一號，下稱「系爭專利」)。
2. 被告韓商周星工程公司為一韓國之半導體、平面顯示器與液晶顯示器製程設備製造商，而主營業所設於台灣新竹縣之被告英屬蓋曼群島商周星科技公司係韓商周星工程公司關係企業之一，與韓商周星工程公司共同為半導體、平面顯示器與液晶顯示器製程設備之經銷、客戶服務及其他業務，有被告於其網站上公布之資料為憑(原證二號)。
3. 據被告所製作之用於介紹並推廣系爭 TFT LCD PECVD 設備之行銷資料(原證三號)以及被告於本件訴訟中所提出之文件顯示，被告製造並在台灣銷售之用於液晶顯示器(LCD)之 Euroka 6000 電漿輔助化學氣相沈積設備(PECVD)，顯侵害原告系爭專利(詳後述侵權分析)。

4. 爭點一：關於申請專利範圍解釋

(1) 按最高行政法院業於 99 年 9 月 16 日以 99 年度判字第 945 號判決肯認台北高等行政法院 97 年度訴字第 00739 號判決及智慧局舉發不成立審定書中有關系爭專利「申請專利範圍解釋」之各項爭點，被告所為之錯誤解釋皆一一被最高行政法院及高等行政法院所駁斥不予採納，不容被告再事爭執；且最高行政法院判決亦揭示有關先前技術是否揭露系爭專利技術特徵之判斷原則，足資遵循。

① 最高行政法院 99 年度判字第 945 號確定判決（下稱「前開最高行政法院判決」）足以證明：本件訴訟中被告所提出有關「申請專利範圍解釋」之各項爭點，與被告該行政訴訟程序中所提出之爭點乃完全相同（即：懸置機構與氣體散流盤是否須為兩個獨立的構件？懸置機構是否需有『間隙分隔』或需由『四片』構成才可彎曲？懸置機構之可彎曲部分是否有某特定長度之限制？，懸置機構之可彎曲程度是否需進一步限定？一般金屬延展性與可彎曲根本是否相同？），而該最高行政法院判決業已針對此等申請專利範圍解釋之爭點一一為認定，今最高行政法院判決既已就該等有關申請專利範圍解釋作終局判決，被告於本件民事訴訟程序中自不得再行主張或爭執，本院亦不宜就專利同一保護範圍作不同之認定。

② 次按，被告於本件民事訴訟主張系爭專利無效之證據為證據 2、證據 3 及證據 2 與證據 3 兩者之結合共三種情況，原告引用前開「最高行政法院判決」足以證明：

(甲) 有關被告以證據三做為主張系爭專利無效之單一證據之主張，前開「最高行政法院判決」已認定證據 3 並未揭露系爭專利之技術特徵，即系爭專利相較於證據 3 具有新穎性與進步性，則依智慧財產案件審理細則第 28 條第 2 項所揭示：「關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限，或其他依法已不得於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張。」之規定，被告於本件民事訴訟程序中自不得再行以同一證據三主張或爭執系爭專利無效。

(乙) 其次，最高行政法院確定判決肯認由於證據 3 並未揭露有一具有「位於氣體散流盤之上之至少一可彎曲部分之懸置機構」，因此證據三並不具備系爭專利之技術特徵，故不足以否定系爭專利之新穎性及進步性。因此，在本件民事訴訟中，

當檢視其他先前技術（即證據 2）時，亦應採取與前開最高行政院所採之相同判斷原則，即：若先前技術之懸置機構未同時具有「位於氣體散流盤之上且可彎曲」之技術特徵時，即無法否定系爭專利之新穎性及進步性。換言之，具有「位於氣體散流盤之上之至少一可彎曲部分之懸置機構」乃系爭專利之技術特徵，此項技術特徵不可分割而視，

(2)解釋申請專利範圍時，應以申請專利範圍本身之文字意義為其主要認定依據，不得以說明書中對於「實施例」之說明限縮解釋申請專利範圍。

①按經濟部智慧財產局(以下簡稱智慧局)所制訂之《專利侵害鑑定要點》第三章第一節第四段闡明「解釋申請專利範圍之原則」時，依序揭示以下原則：

(甲)以申請專利範圍為準之原則：「專利權範圍主要取決於申請專利範圍中之文字，若申請專利範圍中之記載內容明確時，應以其所載之文字意義及該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知或瞭解該文字在相關技術中通常所總括的範圍予以解釋」、「申請專利範圍中每一請求項中之文字均被視為已明確界定發明專利權範圍」、「申請專利範圍之記載內容與發明(或新型)說明或圖式中之記載內容不一致時，應以申請專利範圍之記載內容認定專利權範圍」。

(乙)發明(或新型)說明及圖式為輔助之原則：「為認定專利權範圍之實質內容，發明(或新型)說明及圖式均得為解釋申請專利範圍之輔助依據」、「申請專利範圍中所載之技術特徵明確時，不得將發明(或新型)說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍」、「申請專利範圍中所載之技術特徵不明確時，得參酌發明(或新型)說明與圖式解釋申請專利範圍」、「申請專利範圍之記載內容與發明(或新型)說明及圖式所揭露的內容不一致時，應以申請專利範圍為準」。

②依上開智慧局所揭示的原則可知，解釋申請專利範圍時，應以申請專利範圍本身之文字意義為其主要認定依據，故於解釋申請專利範圍時，自不得援引完全未見於申請專利範圍甚至未見於說明書中之事項，或與申請專利範圍及說明書所載內容無關之事項，對於申請專利範圍作限縮解釋，否則即與上開智慧局所揭示的原則相違背而顯無可採。

③最高法院確定判決業已認定，解釋申請專利範圍時，不得將說明書中對於「實施例」之說明，用以限縮解釋申請專利範圍：

最高法院確定判決業已認定高等行政法院以下認定正確

無誤，不容被告再事爭執：「系爭專利說明書中所舉之「實施例」，僅係用於藉以幫助瞭解系爭專利之實施，並非用以限定系爭專利之申請專利範圍。特別是系爭專利說明書於第 24 頁「發明說明」乙節最末段明確表示：『雖然本發明以較佳實施例說明如上，此僅係用於藉以幫助瞭解本發明之實施，並非用以限定本發明之申請專利範圍；凡熟悉此技藝者於領悟本發明之精神後，在不脫離本發明之精神和範圍內，當可作各種更動與潤飾及等效之變化替換，因此本發明的保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者及等同領域而定』。」（請參高等行政法院判決第 43 頁第 16 行以下）。

(3)系爭專利申請專利範圍並未要求或限制懸置機構與氣體散流盤之必須為兩個獨立的構件。

①懸置機構與氣體散流盤不論係兩個「獨立之構件」相連接或「一體成型」相連接皆為系爭專利申請專利範圍所涵蓋，高等行政法院於判決理由中早已就此詳述理由，並經最高行政法院判決確定：

(甲)被告對系爭專利舉發時主張：「被舉發案申請專利範圍應明確載明氣體散流盤與懸置機構係為各自獨立之構件；否則被舉發案應因為申請專利範圍不被說明書且已涵蓋習知技術而被撤銷專利」云云（原證 95 號，被告 94 年 9 月 29 日專利舉發補充理由書三第 6 頁）。

(乙)然查，系爭專利申請專利範圍並未要求或限制懸置機構與氣體散流盤之必須為兩個獨立的構件，故最高行政法院確定判決業已認定，高等行政法院以下針對系爭專利申請專利範圍之解釋與有效性之認定正確無誤，不容被告再事爭執：「系爭專利之技術特徵在於懸置機構有一第一端、一第二端、及該第一端與該第二端之間且位於該氣體散流盤之上的至少一可彎曲部分（第 1 至 39 項）；該第一端連接於該背壁；該第二端連接於該氣體散流盤；以及該懸置機構圍繞著該進氣歧管中的區域，該區域延伸至該背壁與該氣體散流盤之間。至於該懸置機構與背壁或氣體散流盤是否為一體成型則並非系爭專利之特徵。」（請參高等行政法院判決第 42 頁倒數第 8 行以下至第 43 頁第 3 行）。換言之，最高行政法院業已認定申請專利範圍並未限定懸置機構與氣體散流盤應為二個獨立構件，至為明確。被告於本件訴訟中所提出之理由皆為最高行政法院及高等行政法院所審酌，並未提出任何其他足以改變最高行政法院及高等行政法院之認定的新理由。

(丙)至於申請專利範圍中之用語「連接」係表示懸置機構與氣體

散流盤係處於連接之狀態，並無限制「懸置機構與氣體散流盤必須先是兩個獨立構件，再予以連接」之意。從申請專利範圍之文字本身可以看出，系爭專利並未對於懸置機構與氣體散流盤之連接方式有任何之限制，無論該懸置機構與該氣體散流盤是一體成型、或與該氣體散流盤為另一個獨立之元件，都將可達成、也不影響本發明之技術功效。換言之，無論以何種方式產生上述之連接狀態，均可達成系爭專利之功效，因此在未被排除之狀況下，均為申請專利範圍所涵蓋之範圍，至為明確。

(丁)此外，系爭專利申請專利範圍第 1 項之請求標的為「進氣歧管」裝置，並非關於進氣歧管之製造方法，故縱算（假設語氣）在原始生產時本為分離之二部份，但在組成「進氣歧管」之後，兩者即已連接成為一體。換言之，不論以焊接或一體方式形成，請求標的「進氣歧管」在申請專利範圍中之最終結構中各元件均連接為一體。由於申請專利範圍第 1 項所請求者係為「進氣歧管」之最終完成結構，並非特定的製造方法，因此無論原本是否為分離構件，只要懸置機構及氣體散流盤在最終結構中為連接，即屬申請專利範圍第 1 項所涵蓋之範圍。

②申請專利範圍中之元件命名係依其技術特徵為之，因此即使以被告自稱為一體成型設計之產品與系爭專利申請專利範圍第 1 項之懸置機構進行比對，亦可清楚讀出第一端、第二端及該第一端及第二端之間的可彎曲部分。

(甲)申請專利範圍中之不同元件命名係代表其具有不同之技術特徵，而非表示其為分離之構件；因此申請專利範圍第 1 項中之懸置機構與氣體散流盤雖具不同元件命名，然亦可為一體成型結構中之不同部分：

A. 申請專利範圍之解釋係以申請專利範圍本身之文字為準，已如前述。為清楚界定申請專利範圍之技術特徵，故針對具不同技術特徵之各元件給予不同之命名及說明以作為技術特徵之區別。至於具有不同命名之各元件間相互連接關係，則需依申請專利範圍之其他文字敘述作為限制條件加以規範。換言之，具有不同命名之元件係具有不同之技術特徵，但並非表示各元件需為相互分離而不可為一體成型。

B. 以系爭專利而言，申請專利範圍第 1 項中氣體散流盤及懸置機構之命名分別代表其所具有之技術特徵。氣體散流盤係具有對氣體進行散流之技術特徵；而懸置機構則具有吊掛氣體散流盤之結構特徵。由於申請專利範圍第 1 項中並未對兩者

間之連接方式進行限制，因此兩者雖各自具有不同之元件名稱，但仍可能成爲一體成型結構中之不同部分。換言之，除附加式之連接外，氣體散流盤與懸置機構亦可以一體成型之方式連接。此項見解，亦經前開最高行政法院確定判決肯認確定。

(乙)如前所述，系爭專利申請專利範圍第 1 項中之元件命名本身即已明確界定其技術特徵。氣體散流盤之技術特徵在於有氣體散流之結構，因此其係包含具有穿孔之本體部分；懸置機構則爲離開提供氣體散流盤外的部分，且在結構上提供氣體散流盤支撐。由以下示意圖可明顯看出，位於氣體散流盤側邊反 Z 字型之部分係作爲支撐氣體散流盤之用，因此已屬「懸置機構」部分。

(丙)此外，由以上示意圖爲例，懸置機構包括垂直可彎曲部份以及水平延伸部份。在此兩部份交接處有一個轉折角，懸置機構的第二端是氣體散流盤與水平延伸部份相交之處。以轉折角本身而言，由於其抵抗彎曲之能力已受水平向延伸部分的支撐，因此其抵抗彎曲之能力已明顯強於上方無側向支撐之可彎曲部分(垂直部分)。換言之，以技術特徵而言，此轉折角部分(即圖示中所指出之斜線方塊部分)因其可彎曲性遠遜於上方之可彎曲部分，應被認爲非屬於可彎曲部分。

④系爭專利申請專利範圍第 1 項中懸置機構之可彎曲部分並未有「轉折角」之文字，且專利說明書中亦未要求懸置機構之可彎曲部分必須有「轉折角」之限制，因故於解釋申請專利範圍時不得將之引入作爲申請專利範圍之限制。

查系爭專利申請專利範圍第 1 項之文字，對懸置機構及其可彎曲部分均無所謂「轉折角」之限制或敘述。此外，系爭專利說明書中亦未提及任何「轉折角」與「可彎曲」性質之關係且根本完全未要求懸置機構之可彎曲部分須有「轉折角」之限制。相反的，系爭專利說明書中明白教示係懸置機構之可彎曲部分吸納氣體散流盤之熱膨脹，而非因爲任何有關轉折角之部分。(請參見專利說明書第 15 頁第 14-17 行)因此，在對系爭專利申請專利範圍第 1 項之「可彎曲部分」進行解釋時，若將可彎曲部分解釋成另需包含有「轉折角」部份，顯係增加申請專利範圍所未有之限制，而屬違背解釋申請專利範圍之原則。

(4)系爭專利申請專利範圍第 1 項之主要技術特徵在於有一「至少一可彎曲部分『位於氣體散流盤之上』之懸置機構」，被告將系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵曲解並限縮爲

「一可彎曲之懸置機構」，顯然錯誤。

- ①系爭專利申請專利範圍第 1 項之特徵在於有一具有至少一可彎曲部分位於氣體散流盤之上之懸置機構，並藉此可彎曲部分容納氣體散流盤之熱膨脹。此由系爭專利申請專利範圍本身之文字即明確可知。
 - ②最高行政法院確定判決業已認定，高等行政法院以下針對系爭專利之特徵之認定正確無誤，不容被告再事爭執：「系爭專利之特徵是在於懸置機構，其具有一位在氣體散流盤之上的可彎曲部分。此特徵可以達到『解決氣體散流盤因為熱膨脹所造成的扭曲及破裂問題』及『在處理室壁及該氣體散流盤之間施予實質熱阻抗』功效。」（請參原證 69：高等行政法院判決第 43 頁第 4 行至第 7 行）之理由，業經前開最高行政法院判決確定。
 - ③故前開最高行政法院判決已確定肯認原告之解釋，認定系爭專利之特徵從系爭專利之申請專利範圍文字本身即明顯可知，係在於具有至少一可彎曲部分位於氣體散流盤之上之懸置機構，並藉此可彎曲部分解決氣體散流盤因為熱膨脹所造成的扭曲及破裂問題並施予實質熱阻抗。
- (5)一般金屬延展性與可彎曲根本是兩種不同的概念，金屬具有一般延展性並不代表其必然可彎曲，原告與智慧局之見解自始至終並無任何不一致之處或前後矛盾，高等行政法院於判決理由中早已就此詳述理由，並經前開最高行政法院判決確定：
- ①以一般熟習此項技藝之人士皆知，「延展性」與「可彎曲性」係為不相同但亦不互斥之兩個性質概念。「延展性」係為材料先天之基礎性質，每種材質之延展性均為固定，無法以人力改變；而「可彎曲性」則為在最終裝置上之力學特徵，係可以後天人為之設計調整，自與「延展性」之概念完全不同。
 - ②查智慧局在舉發不成立審定書中第 5 頁第(五)-1-(2)節稱：「金屬材質(鋁材質)具有延展性，其於受到外力時有可能產生形變或彎曲，此故為金屬材質(鋁材質)之固有特性，亦為眾所皆知，然其必須有特定的設計方能應用及承受氣體散流盤之熱膨脹應力，換言之，在證據三或系爭專利之系統操作條件下，並非只要是鋁材質就可彎曲(尚需視其尺寸長厚比例及承受之外力)，或其彎曲程度足以緩衝該系統之熱膨脹應力」等語，其意係指一般金屬雖然具有延展性，但並非只要有延展性就可彎曲，換言之，金屬具有延展性有

可能可以彎曲，但亦可能無法彎曲，端視是否具有特殊之設計而定。原告之系爭專利與被告之系爭產品正是以具有延展性之金屬加以特殊設計而使懸置機構可彎曲之例子。

㉑次查，原告在舉發程序所稱：「材料具延展性並不表示該材料的最終結構必然可彎曲」（請參原證號 95 年 7 月 17 日舉發補充答辯書第 5 頁第 10-11 行）等語，亦係指「由具有延展性之材料所製成之最終結構有可能可以彎曲，亦有可能不可以彎曲」。此外，原告在民事準備書(七)狀稱：「原告(即參加人)於舉發答辯狀之陳述及智慧局舉發審定書意見中，均未將『一般金屬之延展性』排除於『可彎曲』之適用範圍外…」等語，亦係在進一步澄清：一般金屬延展性與可彎曲根本是兩種不同的概念，金屬具有一般延展性並不代表其必然可彎曲，具有延展性之材料所製成之最終結構有可能可以彎曲，亦有可能不可以彎曲，至為明確。故原告不僅本身之立場前後一致，並無矛盾之處，且與智慧局之見解亦始終相符，彰彰甚明。

(6)前開最高行政法院確定判決業已認定「懸置機構並非必需有『間隙分隔』或需由『四片』構成才可彎曲」，且「『間隙』或『四片』並非系爭專利之必要技術特徵」、「縱算懸置機構為『完整而不中斷』皆可據以實施而仍可達到系爭專利發明之目的」。

㉒前開最高行政法院確定判決業已認定，高等行政法院以下認定正確無誤，不容被告再事爭執：

系爭專利申請專利範圍第 1 項並無任何「間隙」或「四片」之字眼，故顯並未限定懸置機構必須有間隙分隔或必須為四片，因此，前開最高行政法院肯認台北高等行政法院之以下見解：「氣體散流盤可以為不同之形狀（圓形、方形、或其他形狀），故懸置機構可配合氣體散流盤形狀而做不同之設計，故其懸置機構是否為多數個部件組成且各部件間以『間隙』間隔則非為系爭專利之必要特徵。」（請參原證 69：高等行政法院判決第 42 頁倒數第 2 行以下至第 43 頁第 3 行）。「系爭專利之特徵是在於懸置機構，其具有一位在氣體散流盤之上的可彎曲部分。此特徵可以達到『解決氣體散流盤因為熱膨脹所造成的扭曲及破裂問題』及『在處理室壁及該氣體散流盤之間施予實質熱阻抗』功效。懸置機構為四片並非用來達到這些功效的一必要特徵，故不需要在所有獨立項中包含『四片』要件。其次，由力學之觀點而言，懸置機構是否由四片構成與是否為可彎曲以實施並無關聯性。懸置機構

是否由四片構成，僅使懸置機構角落附近之力學行為有所不同，但兩者之懸置機構均為可彎曲。換言之，無論懸置機構是否由四片構成，懸置機構均為可彎曲，原告（即本件訴訟之被告）指稱懸置機構必需由四片構成始能據以實施，洵無足採。」（請參高等行政法院判決第 43 頁第 4 行至第 15 行）。

②被告所稱有關「若氣體散流盤為方形時，其懸置機構必須有間隙分隔，否則即會破裂」云云，不僅毫無根據，且與申請專利範圍之解釋無關：

(甲)被告主張若為完整而不中斷的設計則懸置機構必然會產生破裂云云，顯無可採且顯與申請專利範圍之解釋無關：

A. 按系爭專利之技術特徵在於懸置機構的可彎曲性與懸置機構的位置。即使在懸置機構為「完整而不中斷」的設計下，因懸置機構具有可彎曲性，不論是側壁或其角區域，都是可彎曲的，並非如被告答辯(10)狀及 99 年 9 月 15 日開庭簡報第 49 頁中所稱必然會發生側壁斷裂分開之狀況，被告空言主張，顯毫無根據。

B. 次按，懸置機構之角區域是否會產生斷裂分開之狀況，與申請專利範圍之解釋要屬無關，蓋解釋申請專利範圍應以申請專利範圍本身之文字意義為其主要認定依據如前所述，被告先妄加論定若為完整而不中斷的設計則懸置機構必然會產生破裂，再進而主張申請專利範圍必須為非完整而不中斷之設計云云，顯毫無根據而洵無可採。

(乙)被告主張韓國對應案之每一項獨立項的懸置機構均定義為「四片」或「多片」之「非完整而不中斷（有間隙）」之設計、故系爭專利亦應同等限縮云云，顯無可採，且顯與系爭專利之申請專利範圍之解釋無關：

A. 按專利法或專利審查基準並未規定一申請案之申請專利範圍必須包括與國外對應案之申請專利範圍中相同的技術特徵。蓋不同國家具有不同的專利制度與審查標準，且專利權人本就有權利在不同的國家視其需要申請不同的專利範圍，被告之論點顯主張同一發明的各國之申請專利範圍都應包括相同的技術特徵云云，不僅甚為荒謬且毫無根據。

B. 況查，美國對應案（US 6,477,980）之總項數共有 18 項，其中並未限定懸置機構需有「間隙」分隔之項數就有 12 項（第 1,2, 3,4,9,10,11,12,13,16,17,18 項），韓國對應案（No.00-000000）之總項數共有 26 項，其中並未限定懸置機構需有「間隙」分隔之項數有 20 項（第 1, 2, 3, 12-15, 17,

20, 22, 30-32, 40-43, 45, 48, 50 項) , 由此可明顯看出, 該等申請專利範圍皆並未要求懸置機構必須是切成『四片』之『非完整而不中斷(有間隙)』之設計, 由此足證被告所言顯然完全不實。

C. 因此, 被告答辯(11)狀所附韓國對應案所提呈之產品設計圖, 當然與系爭專利無關, 不得用以限縮解釋系爭專利之申請專利範圍, 至為明確。

(丙)綜前所述可知被告主張若氣體散流盤為方形時, 其懸置機構必須有間隙分隔云云, 係以曲解專利說明書內容之方式所得出之謬誤結論, 根本並非本於申請專利範圍本身之解釋, 顯無可採。

(7)系爭專利申請專利範圍之揭示已屬明確, 無須限制懸置機構之可彎曲部分應為某特定長度, 亦無須限定可彎曲之程度, 高等行政法院於判決理由中早已就此詳述理由, 並經最高行政法院判決確定:

①被告於 99 年 9 月 15 日開庭簡報第 58 頁引述原告於舉發程序中答辯「被舉發案申請專利範圍第 1 項所界定之至少一可彎曲部分係位於氣體散流盤之上, 藉以使該可彎曲部分盡可能的長, 以容納氣體散流盤的熱膨脹, 而使可彎曲部分的長度不會受限於氣體散流盤的厚度」等語, 並進一步於 99 年 9 月 15 日開庭簡報第 60 頁中稱: 「懸置機構之長度『小於氣體散流盤厚度者』, 不在系爭專利之權利範圍內」云云, 然被告所稱顯毫無根據, 洵無可採。

②蓋原告於舉發程序中之上述答辯係在強調位於氣體散流盤之上可彎曲部分之技術特徵, 可防止可彎曲部分長度受到氣體散流盤的厚度之限制, 即可彎曲部分之長度可依設計需求或材料特性的改變來選擇。原告所謂「藉以使該可彎曲部分盡可能的長」之敘述, 為系爭專利「至少一可彎曲部分係位於氣體散流盤之上」的結構中所衍生之優點, 而非對可彎曲部分作結構上的限制。

③於解釋申請專利範圍時, 應以申請專利範圍本身之文字意義為其主要認定依據。從系爭專利之申請專利範圍文字本身即明顯可知, 系爭申請專利範圍就懸置機構之可彎曲部分, 並無任何長度之限定。系爭專利說明書第 3 頁至第 4 頁有關係爭專利之發明目的載明: 「本發明係有關一種用於電漿室的氣體進氣歧管, 此歧管包含一穿透之氣體散流盤 (gas distribution plate), …… , 且此側壁 (或稱懸置機構) 中可以容忍氣體散流盤的熱擴散或熱收縮, 本發明之優點在

於避免因爲熱擴散或熱收縮而導致氣體散流盤的斷裂或扭曲。」，由是可知，申請專利範圍第 1 項所謂爲之「可彎曲」應係指其彎曲程度足以容納氣體散流盤的因熱所產生之膨脹應力，換言之，即藉由可彎曲之懸置機構而降低氣體散流盤上的機械應力。

④前開最高行政法院亦肯認原告之主張並認定系爭案申請專利範圍中以「可彎曲」作爲技術特徵已然明確，無須進一步界定可彎曲部分之長度，亦無須進一步限定彎曲之程度。

(甲)前開最高行政法院確定判決業已認定，高等行政法院採納智慧局以下認定正確無誤，不容被告再事爭執：「舉發人指稱前述懸置機構可彎曲部分應於各獨立項界定可彎曲之程度，惟查系爭案前述申請專利範圍亦界定其「可彎曲」之特徵，說明書亦明白界定其做爲緩衝熱膨脹應力及施予實質熱阻斷之作用，至於彎曲之程度熟悉該項技術之人士自可藉由系爭案之揭示而針對不同之操作條件做調整及設計，故系爭案前述申請專利範圍各獨立項揭示應已屬明確」之理由（審定書第 8 頁第 13-20 行）。

(乙)由此足證最高行政法院亦肯認原告之主張並認定系爭案申請專利範圍中以「可彎曲」作爲技術特徵已然明確，無須進一步界定可彎曲部分之長度，至於「特定的設計」及足以緩衝熱膨脹之「彎曲程度」部分係可由熟悉該項技術之人士依系爭專利之揭示來加以調整。既然申請專利範圍在未加入特定設計細節及彎曲程度的狀況下即已明確，於進行申請專利範圍解釋時自不得以特定設計細節及彎曲程度來對申請專利範圍加以限縮。

⑤此外，系爭專利申請專利範圍對於懸置機構之可彎曲敘述本身即爲技術上之限定條件，而說明書中之敘述則作爲例示之用；系爭發明乃以「具有位於氣體散流盤之上的至少一可彎曲部分之懸置機構」爲手段，俾達到「避免散流盤之斷裂或扭曲」之效果。故所謂「具有位於氣體散流盤之上的至少一可彎曲部分之懸置機構」乃系爭專利所用以解決問題之「手段」，而「避免散流盤之斷裂或扭曲」則爲系爭專利所達成之「效果」，就申請專利範圍解釋而言，斷無以系爭專利說明書中所述之「效果」來限定申請專利範圍之可能，故被告企圖以系爭專利之目的來限定申請專利範圍，於 99 年 9 月 15 日開庭簡報資料第 59 頁稱「就結果而言可彎曲應該低至避免散流器的扭曲或裂痕、就程度而言弧度爲 1.7 度」云云，顯無可採。

5. 爭點二：關於專利有效性

(1) 前開最高行政法院判決業已確認：系爭專利申請專利範之技術特徵「具有一位於氣體散流盤之上至少一可彎曲部份之懸置機構」且證據 3 並未揭露或教示此項特徵，故證據 3 並無法作為使系爭專利無效之先前技術。同樣的，證據 2 亦並未揭露或教示「一位於氣體散流盤之上至少一可彎曲部份之懸置機構」之特徵，因此，若以與最高法院及高等行政法院所認定證據 3 缺乏之技術特徵相同的先前技術認定系爭專利無效，將顯然有悖最高法院及高等行政法院之確定判決，故不論是證據 3 單獨或與證據 2 結合，均無法使系爭專利被認定為無效。

(2) 系爭專利第一次舉發案之舉發不成立審定係以證據 3 之固定懸掛壁 130 及可彎曲的薄壁 146，與系爭專利之懸置機構比對，並參考證據 3 中之薄壁 146 之可彎曲性，仍認為系爭專利具有新穎性及進步性；此一見解並已為最高行政法院所確定。

① 證據 3 揭露一位於氣體散流盤側面之可彎曲薄壁 146，以及一位於氣體散流盤之上的固定懸掛壁 130，如原告民事言詞辯論意旨狀第 29 頁圖示：由證據 3 說明書 column 4, line 46 to 51 所載：「the thin wall 146 has a length much longer than its thickness. Therefore, it can flex and bend in the radial direction of the faceplate 100, thereby accommodating thermal distortions while only minimally influencing the position of the showerhead 102（中文翻譯：薄壁 146 之長度遠大於其厚度。因此，薄壁 146 可以在面板 100 之直徑方向撓曲及彎折，藉以吸納熱變形並最小化對散流盤 102 位置影響最小化。）」等語，以及智慧局舉發不成立審定書第 5 頁(五)1(2)節第 1 行所載：「證據三…形成一薄壁 146，藉此薄壁以將噴灑頭 102 與其支撐壁作熱隔絕以及緩衝熱膨脹產生之應力，其做為熱隔絕以及緩衝熱膨脹產生之應力之原理固然與系爭專利利用可彎曲之懸置機構 24 以達成熱阻隔及緩衝熱膨脹產生之應力之原理相同，但兩者之結構並不相同。」等語可知，證據 3 中之薄壁 146 不僅提供「熱阻抗」，同時亦具有「可彎曲」之特性並可緩衝熱膨脹；且薄壁 146 之可彎曲性質已為 N01 舉發案之審定理由所考慮，但智財局仍認定系爭專利之可專利性不受證據 3 之影響，蓋因掛壁 130 係不可彎曲，而可彎曲的薄壁 146 不在氣體散流盤之上，且證據 3 並未揭露或建議

使懸置機構具有一位於氣體散流盤之上的可彎曲部分，此見解業經最高行政法院確定判決所維持。

②此外，由證據 3 說明書 column 4, line 45 所載：「Because of the large temperature difference across the thermal choke represented by the deep grooves 140, 142 and associated thin wall 146, the hot showerhead 102 will expand relative to the cooler hanger wall 130. (中文翻譯：由於深溝 140、142 及可彎曲之薄壁 146 所形成之熱節閥兩側有大的溫度差，因此熱的散流盤 102 將會相對於冷的懸掛壁 130 膨脹。)」等語可知，證據 3 中由深溝 140、142 及可彎曲之薄壁 146 組成之結構可讓散流盤 102 在保持懸掛壁 130 不彎曲的狀況下膨脹；另智慧局之審定書第 5 頁(五)1(2)節第 20 行亦有相同的認定：「故證據三縱然使用金屬或鋁材質為懸置壁 130，但全文並未有任何說明及界定指出該懸置壁 130 係可彎曲之特徵…」。綜上所述，審查委員在判斷時確實是以懸掛壁 130 與系爭專利之懸置機構進行比對，並已參酌薄壁 146 之可彎曲性質。然審定書中最終仍認定證據 3 之懸掛壁 130 為不可彎，且與系爭專利申請專利範圍第 1 項之結構不同，因此熟悉此項技藝者無法依據證據 3 之揭示而輕易完成系爭專利之申請專利範圍第 1 項，系爭專利申請專利範圍第 1 項相對於證據 3 具有新穎性及進步性；此一見解並已為最高行政法院所肯認維持。

(3)系爭專利申請專利範圍第 1 項之多項技術特徵未為證據 2 所揭露，尤其是證據 2 並未揭露位於氣體散流盤之上可彎曲部分之懸置機構，故系爭專利相對於證據 2 具有新穎性及進步性。系爭專利申請專利範圍第 1 項中之多項技術特徵未為證據 2 所揭露，如下表所示並詳述如後：

| 系爭專利 Claim 1 | 證據 2 | 是否揭露 |
|----------------------------------|-----------------------------|------|
| 懸置機構具有位於該氣體散流盤之上的至少一可彎曲部分 | 分離板彎曲部(5b)位於分離板本體(5a)下方 | 否 |
| 請求標的為進氣歧管：氣體散流盤上之出氣穿孔與背壁上之進氣孔與「該 | 非進氣歧管：在分離板本體(5a)及微波導入窗(4)間傳 | 否 |

| | | |
|--|---|---|
| 進氣歧管中延伸於該背壁與該氣體散流盤之間的區域」之間「流體傳遞」，以將自進氣穿孔進入進氣歧管之反應氣體經出氣穿孔均勻送入下方電漿反應室中。 | 遞者為電漿而非反應氣體，因此非進氣歧管。 | |
| 具有背壁： 1. 背壁有一進氣穿孔。 2. 懸置機構的第一端連接於該背壁。 3. 進氣歧管中延伸於該背壁與該氣體散流盤之間的區域。 | 無背壁： 1. 微波導入窗(4) 無進氣穿孔，且未與分離板彎曲部(5b)之一端連接，因此微波導入窗並非背壁。 2. 反應容器(1) 之外側壁並未與分離板主體(5a)間形成一區域；因此外側壁亦非背壁。 | 否 |
| 該懸置機構圍繞著該進氣歧管中的區域。 | 分離板彎曲部(5b)所圍者為反應室內之區域，而未圍繞進氣歧管中之區域。 | |

①證據二之分離板彎曲部(5b)並不位於分離板主體(5a)上方，如原告民事言詞辯論意旨狀第 32 頁圖示。因此證據 2 並未揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項中「位於該氣體散流盤之上的至少一可彎曲部分」之技術特徵，至為明確，被告對此亦未爭執。

②證據二未揭示氣體散流盤與氣體進氣歧管之間之流體傳遞：系爭專利申請專利範圍第 1 項要求氣體散流盤上之出氣穿孔與背壁上之進氣穿孔與「該進氣歧管中延伸於該背壁與該氣體散流盤之間的區域」之間「流體傳遞」，如原告民事言詞辯論意旨狀第 33 頁上圖所示。而證據 2 中，分離板主體 5a 接收來已於電漿室 2 形成之「電漿」，而非「反應氣體」。因此，不得將證據二之電漿室 2 視為等同系爭專利之「氣體進

氣歧管」。且證據二之分離板主體 5a 無法如同系爭專利申請專利範圍第 1 項所述般與「該進氣歧管中之區域」之間流體傳遞，如原告民事言詞辯論意旨狀第 33 頁下圖所示。由此可知，系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據二間之結構及功能完全相異。蓋證據二之分離板主體 5a 為電漿室之出口，而系爭專利申請專利範圍第 1 項之氣體散流盤為形成電漿之區域的入口。

④證據 2 顯然缺少申請專利範圍第 1 項所述之「背壁」：申請專利範圍第 1 項界定「背壁有一進氣穿孔」。因為微波導入窗 4 缺少進氣穿孔，微波導入窗 4 無法成為申請專利範圍第 1 項之背壁；此外，證據二中亦未揭示將分離板彎曲部 5b 連接至微波導入窗 4。反應容器 1 之外側壁亦未能界定如系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項所要求之「該進氣歧管中延伸於該背壁與該氣體散流盤之間的區域」，因此無法成為申請專利範圍第 1 項之背壁

④證據 2 之分離板彎曲部未圍繞進氣歧管之區域：系爭專利申請專利範圍第 1 項之該懸置機構圍繞著該進氣歧管中的區域，該區域延伸至該背壁與該氣體散流盤之間，且其中之該進氣穿孔與該出氣穿孔為該區域的流體傳遞。而在證據二中，被告指稱分離板彎曲部 5b 「圍繞」元件符號 2 所代表之區域，即電漿室 2。然電漿室 2 並不同於進氣歧管；且分離板彎曲部 5b 亦未「圍繞」電漿室 2，已如原告民事言詞辯論意旨狀第 35 頁圖所示。

④綜上所述，證據 2 並無法揭露多項系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵，故系爭專利相對於證據二具有新穎性及進步性。

(4)證據 2 及證據 3 欲解決之問題不相同，且兩者之技術內容並未促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在一起，故證據 2 及證據 3 之組合並非明顯：

①證據 3 之說明書「Background Art」一節中，column 2 第 49 行以下提到：「The heat sinking at the circumference of the showerhead causes at least two related problems. ...The thermal stresses cause the showerhead 24 to bow, and the resultant variable gap size of the processing space introduces a non-uniform plasma, ...」（中文翻譯：散流盤周圍的熱散失造成了至少兩個相關問題。...熱應力造成散流盤 24 扭曲，且因而使反應空間之間距尺寸相應變化而不一致，進而造成不

均勻的電漿)」此外，在「Summary of the invention」一節中，column 3 第 6 行以下則敘及：「The wall acts as a thermal choke, more effectively thermally isolating the showerhead from its support and vacuum seals. It also acts as a mechanical bellows for accommodating thermal expansion. (中文翻譯：薄壁被用來作為熱節閥，以有效地在散流盤及其支撐及真空封環間形成熱隔絕。薄壁亦被用來作為機械摺箱，以吸納熱膨脹)」由此可清楚知道，證據 3 欲解決之問題是氣體散流盤受熱膨脹造成在氣體散流盤上的熱應力扭曲問題。

- ②對於證據 3 而言，之所以需解決熱應力扭曲之問題，其原因在於此類型之 PECVD 裝置係為單一腔體設計，即以同一腔體作為電漿室及反應室。由於需激發反應氣體以形成電漿，因此需在氣體散流盤及下方基板載台間形成電場，方能激發經由氣體散流盤進入電漿室內之反應氣體。以大尺寸之氣體散流盤而言，若氣體散流盤之熱膨脹不能得到適當的緩解，則勢必造成氣體散流盤本身之熱應力扭曲現象。當氣體散流盤上產生熱應力扭曲時，則會使氣體分佈不均，並同時使氣體散流盤下方之電場產生不均勻分佈。此時會使電漿生成之密度不均勻，進而影響產品上沈積之厚度不一，形成瑕疵品。由上述可知，對於採用證據 3 單一腔體設計之 PE CVD (氣相沈積設備)，方需解決氣體散流盤上熱膨脹造成之熱應力扭曲問題。
- ③反觀證據 2，係為了解決在與證據 3 完全不同的設備在製程中產生金屬微粒子而造成產品瑕疵的問題；依被告提供之證據 2 說明書中譯本第 1 頁「發明摘要」第一行所述：「本發明提供一種電漿處理裝置，其係包含分離板之降流型電漿處理裝置」；另依證據 2 說明書中譯本第 3 頁第 2 段中對該發明「降流型」電漿處理裝置之說明可知：「於該電漿處理裝置中，反應容器 1 內部藉由以鋁(Al)等所製作之分離板 5 分成電漿室 2 與反應室 3。該分離板 5 …自電漿室 2 中所產生之電漿中將試樣處理所需之自由基或離子選擇性地導出至反應室 3。此時，可藉由使該分離板 5 接地、改變電漿導出孔 5e 之大小、或者增加分離板 5 之厚度等來改變電漿之導出條件。…只要使電漿導出孔 5e 夠小，便可藉由分離板 5 消除離子而僅將自由基導出至反應室 3。」
- ④由上述可知，證據 2 之發明係用於「降流型」之電漿處理裝置，此類裝置之「電漿室」及「反應室」是分開的，電漿室

係位於分離板 5 之上，以先在「電漿室 2」中產生電漿，再將電漿送入「反應室 3」內進行化學反應，此與證據 3 乃完全不同之結構。證據 2 不僅是在整體結構上與證據 3 完全不同，且證據 2 中之分離板 5 之用途僅係在過濾電漿中之雜質；此與證據 3 中氣體散流盤係爲了散流反應氣體並能夠均勻的在散流盤下方的電漿反應室產生電漿之用途完全不同。因此，在發明所屬技術領域中具有通常知識之人當欲解決與爲均勻散流氣體目的之設備有關之問題時，並不會輕易想到要去參考爲了過濾電漿中雜質目的之設備。

⑤再者，由於降流式之電漿處理裝置之電漿已在電漿室 2 中產生，並藉由擴散方式穿過分離板 5 進入反應室 3。因此分離板 5 是否扭曲變形並不會對電漿之生成及分佈產生影響，亦不會影響反應結果；此外，降流式之電漿處理裝置之分離板 5 與基板間並未有電場形成，因此分離板 5 之扭曲變形與否亦不會影響電場分佈，故不會影響反應結果。由此可知，證據 2 使用降流式電漿處理裝置並不需要解決分離板 5 扭曲變形之問題，因此當發明所屬技術領域中具有通常知識者遇到證據 3 之散流盤扭曲變形問題時，並無法輕易想到參考證據 2 降流式裝置之設計。

⑥實際上，依證據 2 說明書中譯本第 4 頁第 3 行「發明欲解決之問題」一節中記載：「…分離板伸縮而使位於分離板外周部固定分離板的部分產生摩擦，從而引起產生金屬微粒子即顆粒之問題。」，可知證據 2 主要欲解決之技術問題在於製程中金屬微粒子造成產品瑕疵，而與氣體散流盤上之熱應力扭曲問題無關。故被告於 99 年 9 月 15 日開庭簡報第 30 頁主張證據 2 欲解決之問題在於「熱擴散與熱收縮導致分離板扭曲所造成之問題」云云，顯非實在。

⑦此外，如前所述之證據 2 說明書中譯本第 3 頁第 2 段內容所述，證據 2 中之分離板 5 係用來過濾自電漿室輸出至反應室之電漿，僅保留所需之粒子，例如消除電漿中之離子；換言之，分離板 5 並非供作反應氣體散流之用。因此證據 2 中之分離板完全不同於系爭專利中用來使非電漿態之反應氣體均勻分佈之氣體散流盤，兩者並非相同之元件。由於證據 2 中之分離板 5 與證據 3 之氣體散流盤完全不同，已如前述。因此在此領域中具有通常知識者欲解決氣體散流盤上發生之問題時，自不會參考證據 2 中分離板 5 之設計方式。

⑧綜上所述可知，證據 2 與證據 3 所欲解決之問題顯不相同，原告亦已明確指出，然被告於前次開庭簡報第 32 頁主張「原

告不爭執證據 2 及證據 3 與系爭專利均屬相同之技術領域、解決相同之技術問題」云云，顯不實在，洵無可採。

(5)證據 2 已清楚說明其與證據 3 之結合並不恰當，因此兩者技術內容所揭露之必要技術特徵先天即不相容，故其技術內容的組合並非明顯。

①依證據 2 說明書中譯本第 2 頁「先前技術」一節中第 2 段及第 3 段所述：「於該蝕刻方法或灰化方法中，時有因離子衝擊而對基板造成之損害之問題。又，於蝕刻方法中，有時會要求對於基底膜之高選擇比。於此情形時，可使用降流型蝕刻方法或灰化方法。」可知證據 2 之發明係因一般非降流型之製程有上述問題，因此改選擇使用降流型之設計；換言之，證據 2 已明白排除其發明使用在具有上述問題之一般非降流型電漿處理裝置上。

②反觀證據 3，其設計即為非降流型之一般電漿處理裝置，且上述離子衝擊造成基板損害之問題亦存在於證據 3 之設計中，因此證據 3 與證據 2 兩者之組合明顯屬於先天即不相容之狀況。由是可知，對具有通常知識者而言，證據 2 及證據 3 之組合並非明顯而可輕易思及，足證系爭專利具有進步性。

(6)於發明所屬技術領域中具有通常知識之人並無動機去結合證據 2 及證據 3，蓋因證據 3 揭露其已欲解決散流盤熱膨脹之問題。

①如前所述，證據 2 及證據 3 所欲解決之問題不同；證據 2 係用來解決摩擦生成粒子的問題，而非關於解決氣體散流盤的問題，而證據 3 則是欲解決氣體散流盤上之扭曲問題。因此當具有此領域中通常知識者無論是遇到證據 2 或證據 3 之問題時，均不會想到將另一證據所提供之技術方案納入考慮範圍，因兩者欲解決之技術問題有根本性的不同。

②在此領域具有通常知識者欲解決氣體散流盤之扭曲問題時，並不會參考證據 2 中之分離板 5 設置，因為證據 2 之分離板 5 係作為電漿之過濾柵使用，以去除電漿中的某些成份，而非作為氣體散流盤使用。此外，證據 3 之設計係採用單一電漿反應腔室之非降流式設計。具有通常知識者在對證據 2 之系統進行調整時並不會考慮證據 3 之教示內容，因為證據 2 之內容已明白說明其僅適用於電漿室與反應室分離之降流式設計，且採用單一電漿反應腔室之非降流式設計並不恰當。

③此外，由於證據 3 中已藉由元件 146 之設置而企圖解決氣體散流盤扭曲變形之問題，因此具有通常知識者並沒有動機針對解決相同問題而去結合證據 2 至證據 3 中。以另一角度而

言，具有通常知識者已可自證據 3 之元件 146 本身得到可彎曲此一性質之教示，因此具有通常知識者自然不會有動機再將證據 2 中之可彎曲性質結合進入證據 3 之中，蓋因證據 3 已經有一可彎曲部分吸納氣體散流盤之熱膨脹。

(7)縱使假設性地將證據 2 及證據 3 組合，系爭專利申請專利範圍第 1 項相對於證據 2 及證據 3 之組合具有不可預期之功效，因而具有進步性。

❶智慧局於 N01 舉發審定書中明確指出：「系爭專利懸置機構係設於背壁及氣體散流盤之上，結構明顯不同，其可有更大的彈性來做設計以緩衝較大的熱膨脹應力」等語。由此可知，智慧局認定系爭專利與證據 3 之區別之處，在於結構上的明顯不同，以及因結構不同而造成可彎曲部分長度有無受到氣體散流盤厚度之限制，故判定系爭專利之有效性得以維持。換言之，由於證據 3 之可彎曲部分長度受到限制，因此自證據 3 並無法預期系爭專利具有可彎曲部分長度不受結構限制之功效。

❷此外，就證據 2 之設計而言，其分離板彎曲部 5b 係自下方向上支撐分離板本體 5a。當分離板本體 5a 尺寸較大重量較重時，分離板彎曲部 5b 之長度即需相應縮短，以避免因分離板彎曲部 5b 太容易彎曲而欠缺側向支撐力，進而造成分離板本體 5a 向兩側傾倒。換言之，分離板彎曲部 5b 之長度係受限於向上支撐之結構設計，因此自證據 2 亦無法預期系爭專利具有可彎曲部分長度不受結構限制之功效。

❸綜上所述，證據 2 及證據 3 分別均無法預期系爭專利具有可彎曲之懸置機構長度不受限制之功效。因此即便組合證據 2 及證據 3，系爭專利相對於證據 2 及證據 3 亦具有不可預期之功效，亦即其可彎曲之懸置機構長度不受到結構設計之限制，以具有更大的彈性來做設計以緩衝較大的熱膨脹應力。由此可知，系爭專利相對於證據 2 及證據 3 之組合亦具有進步性。

(8)另縱算假設性地將證據 2 及證據 3 組合，亦只能得出可彎曲之懸置機構位於氣體散流盤下方之結果，因此亦無法產生系爭專利之發明

證據 2 所教示者，係為分離板彎曲部 5b 需在分離板本體 5a 之下，分離板彎曲部 5b 之一端連接於分離板本體 5a，而另一端連接於反應室腔體之側壁。此外，由於證據 3 中設置懸掛裝置 130 之位置並未提供任何供懸掛裝置 130 彎曲之空間，可見並不能在證據 3 中以證據 2 之分離板彎曲部 5b 替換懸掛裝

置 130 。，因此可知，若強行組合證據 2 及證據 3 ，所產生之系統中具有之可彎曲懸置機構將會在氣體散流盤下方，故仍未揭露系爭專利在氣體散流盤上方有可彎曲之懸置機構之特徵。故系爭專利相對於證據 2 及證據 3 之組合仍具有進步性。

被告主張將證據 2 的可彎曲部分與證據 3 結合，顯然係我國專利審查基準中所不允許的典型後見之明，蓋因不論是證據 3 或證據 2 皆並未揭露有位於氣體散流盤之上可彎曲部分之懸置機構，故被告此項主張顯然是基於系爭專利所為之後見之明。

6. 爭點三：關於侵權分析

請見密封附件之說明。

7. 爭點四：關於損害賠償

(1) 被告應就其銷售至少四台第 5 代系爭機器予第三人奇美電子股份有限公司所造成原告之損害負損害賠償責任

① 依據被告公司網站所公佈之資料顯示：被告分別於民國(下同)92 年 5 月 30 日與奇美電子股份有限公司(以下簡稱奇美電子公司) 簽訂 1 台第 5 代系爭產品之買賣合約(原證 5 號)、於 92 年 10 月 28 日與奇美電子公司簽訂 1 台第 5 代系爭產品之買賣合約(原證 6 號) ，復於 92 年 12 月 1 日於其網站上發布訊息表示追加簽訂 2 台第 5 代系爭產品及 1 台第 5.5 代系爭產品之買賣合約(原證 7 號) ，足見被告確實銷售予奇美電子公司至少 4 台第 5 代系爭機器。此外，依照原告子公司業凱科技股份有限公司台灣分公司前派駐於奇美電子之客服工程師王善標於 94 年 1 月 20 日所出具之聲明書(原證 41) ，亦可證明被告截至 94 年 1 月 20 日 前確實至少銷售並交付奇美電子共 4 台之系爭機器。

② 依據韓國財務監督服務(Financial Supervisory Service) 網站於 2003 年 6 月 2 日、2003 年 10 月 28 日、2003 年 12 月 1 日及 2004 年 8 月 18 日所公布被告揭露之公開資訊(原證 82 至 85) ，被告分別於 2003 年 5 月 30 日、2003 年 10 月 28 日、2003 年 11 月 28 日及 2004 年 8 月 18 日獲得奇美電子公司共 5 台第五代氣相沈積設備訂單；依據韓國財務監督服務網站於 2003 年 11 月 14 日及 2004 年 9 月 1 日之資料顯示，被告於 2003 年 11 月交付 1 台第五代氣相沈積設備，並於 2004 年 6 月交付 2 台第五代氣相沈積設備(原證 86 至 87) ；依據韓國財務監督服務網站於 2005 年 3 月 30 日之資料顯示，被告 2004 年 8 月 18 日自奇美電子公司獲得之訂單業已交付予奇美電子(原證 88) 。

由上述資料可證被告確實至少業已銷售並交付奇美電子共 4 台之系爭機器。

④ 本院曾多次命被告就原告所主張被告銷售系爭機器之數量表示意見，然被告始終未具狀表示異議。故被告確實至少業已銷售並交付奇美電子公司共 4 台之系爭機器，應無疑義。

(2) 系爭專利產品為氣相沈積設備銷售及使用上不可分離之重要設備，故計算本件侵權損害賠償金額時，應以被告銷售整台氣相沈積設備所獲得之利潤計算

① 本件被告侵害原告專利之氣體散流盤為氣相沈積設備之必要設備，氣相沈積設備沒有氣體散流盤將無法運作，亦即氣體散流盤與氣相沈積設備功能上須互相配合整台氣相沈積設備始得以運作，且氣相沈積設備與氣體散流盤分離後彼此將無法單獨產生功效；氣體散流盤無法以其他公司所製造之氣體散流盤加以置換，市場上氣體散流盤之銷售皆是附隨於氣相沈積設備之銷售，氣體散流盤從未銷售予客戶作為非氣相沈積設備以外之使用，故氣體散流盤與氣相沈積設備彼此間亦具有行銷上之依存關係；倘若被告銷售予奇美電子公司之第五代氣相沈積設備並未裝置有侵害原告專利之氣體散流盤，被告將無法銷售該等第五代氣相沈積設備予奇美電子公司而獲得銷售利益，反而原告將可增加銷售相同數量之氣相沈積設備予奇美電子公司。職是，依據專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定「侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」，應以被告銷售整台氣相沈積設備所獲致之利益作為被告因系爭專利受侵害所蒙受之損害，故計算本件侵權損害賠償金額時，自應以被告銷售予奇美電子公司整台氣相沈積設備所獲得之利潤作為損害金額，始屬合理。

② 關於同一機器中包含侵害專利之裝置及非專利範圍所及之裝置時應如何計算損害賠償金額，我國法院鮮少案例可參。鑑於我國專利法規大多參酌美國專利實務制定，故美國法院關於計算侵害專利損害賠償之實務應可作為我國法院之參考。依據美國法院實務，當專利權人主張侵害專利之損害賠償金額包含其他非屬於專利權範圍之物品價值時，美國聯邦法院係採用「整體市場價值理論」(Entire Market Value Rule)，來檢驗專利權人上述主張是否合理。所謂「整體市場價值理論」係指從典型市場行銷之觀點，若非屬於專利範圍之物品與屬於專利範圍之物品彼此間具有財務上或行銷上之依存關係時，則專利權人於計算侵害專利之損害賠償金額時，得

將同一機器上非專利範圍所及之裝置價值一併計入（原證 89 號：Kori Corp. v. Wilco Marsh Buggies & Draglines, Inc., 761 F.2d 649, 656, 225 USPQ 985, 989 (Fed. Cir. 1985)。

㉑ 歸納美國法院實務對於專利侵害損害賠償計算之判決，若有下列情況之一者，應適用「整體市場價值理論」據以計算侵害專利之損害賠償金額；亦即以整台機器或產品之價格來計算，而不扣除同一機器或產品中非專利範圍所及裝置之價值：

(甲)倘於同一機器中專利範圍所及之裝置與非專利範圍所及之裝置功能上須互相配合該機器始得以運作時（原證 89 號：Kori Corp. v. Wilco Marsh Buggies & Draglines, Inc., 761 F. 2d 649, 656, 225 USPQ 985, 989 (Fed. Cir. 1985)；原證 91 號：Kalman v. Berlyn Corp., 914 F.2d 1473, 1485, 16 USPQ2d 1093, 1102 (Fed. Cir. 1990)；原證 92 號：TWM Mfg.v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 901, 229 USPQ 528 (Fed.Cir. 1986)）；

(乙)倘專利權人係預期專利範圍所及之裝置與非專利範圍所及之裝置將一併於市場上銷售時。換言之，當專利權人本即預期因該專利裝置之存在，將可增加其他非專利範圍所及裝置之銷售時（原證 89 號：Kori Corp. v. Wilco Marsh Buggies & Draglines, Inc., 761 F.2d 649, 656 (Fed. Cir. 1985)；原證 92 號：TWM Mfg. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 900, 229 USPQ 528 (Fed. Cir. 1986)）；

(丙)倘專利範圍所及之裝置與非專利範圍所及之裝置分離後將無法單獨產生功效時（原證 89 號：Kori Corp. v. Wilco Marsh Buggies & Draglines, Inc. 761 F.2d 649, 656 (Fed. Cir. 1985)）；

(丁)倘就整台機器而言，為專利範圍所及之裝置係消費者之重要需求 ("basis for customer demand") 時（原證 90 號：Rite- Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1549 (Fed. Cir.1995)。

如前述，系爭氣相沈積設備與氣體散流盤具有銷售上之依存關係、功能上須與氣體散流盤互相配合該機器始得以運作，且與氣體散流盤分離後將無法單獨產生功效。故依照美國實務見解，本件應以被告銷售整台氣相沈積設備所獲致之利益計算侵權損害賠償金額。

(3)原告請求被告賠償原告因其侵害行為所得利益，符合專利法

之規定：

- ①依照專利法第 85 條第 1 項規定「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第 216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」原告等爰依照前揭專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定向被告等請求損害賠償。
- ②如前述，被告至少銷售四台型號為 EUREKA 6000 之侵權機器予奇美電子公司(原證 80)，依照被告於本件審理訴訟擔保階段自行主張之系爭機器每台機器售價約美金 900 萬元以及同業利潤 15%(原證 80)，原告爰請求被告等連帶給付原告共新台幣一億七千八百二十萬元(NT\$178,200,000)。其計算依據如下：[美金 900 萬元(每台機器售價) × 15%(同業利潤標準) × 4 (被告共販售四台機器予奇美) × 33(美金兌換台幣匯率)] = NT\$178,200,000

(4)原告之損害賠償請求並未罹於時效

- ①民法第 197 條第 1 項規定：「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾十年者亦同。」。次按，最高法院 72 年台上字第 1428 號民事判例表示：「所謂知有損害及賠償義務人之知，係指明知而言。如當事人間就知之時間有所爭執，應由賠償義務人就請求權人知悉在前之事實，負舉證責任。」(原證 27 號)，故本件被告主張原告之擴張請求已經罹於時效，自應由被告舉證證明之。惟如原告歷次書狀所陳，被告迄今無法舉證證明原告於 94 年 12 月 23 日 2 年前即 92 年 12 月 23 日前即已知悉被告等有侵權行為之事實，被告所為時效之抗辯自無可採。
- ②更何況，原告起訴時所為一部請求時所生中斷時效之效力可及於擴張訴之聲明部分之請求，原告所為擴張訴之聲明並未罹於時效。謹說明如下：

(甲)我國民事訴訟法明訂原告得就其請求為一部之主張，其後再擴張請求金額。民事訴訟法第 244 條第 4 項規定：「第一項第三款之聲明，於請求金錢賠償損害之訴，原告得在第一項第二款之原因事實範圍內，僅表明其全部請求之最低金額，而於第一審言詞辯論終結前補充其聲明。其未補充者，審判長應告以得為補充。」再者，我國民法有關時效制度之設，

其目的乃係在避免權利人延宕行使權利致時日久遠而舉證困難，本件原告起訴時，既已行使權利，且業已聲明僅就所受損害之一部先為部分請求，並保留將來擴張聲明之權利，原告並無怠於行使權利。職是，原告起訴為一部請求時所生中斷時效之效力自應及於擴張訴之聲明部分之請求，被告等辯稱原告擴張訴之聲明部分已罹於時效云云，委無足採。

(乙)我國實務亦肯認起訴中斷時效之效力應及於嗣後擴張訴之聲明，故原告擴張訴之聲明並未罹於時效：

A.最高法院 90 年台上字第 2467 號判決明揭：「損害賠償之訴，由於涉及損害原因、過失比例、損害範圍等之認定，加以舉證困難，其損害之具體數額甚難為估算，常需經專家鑑定，始能確定。…擴張應受判決事項之聲明，自仍在原起訴請求之訴訟標的法律關係範圍以內，乃原判決竟認上訴人在第一審擴張請求之三百六十萬八千六百零二元及利息部分，不生起訴之效力，進而以該部分請求已罹於時效為由，據為上訴人敗訴之判決，自有未洽。」（詳原證 46，本案案情與最高法院判決完全相同，自應適用相同法理。）

B.此外，台灣高等法院 89 年上易字第 686 號判決及台灣高等法院 90 年上字第 678 號判決亦明白闡釋：「請求權時效已因起訴而中斷，且查債權人就同一原因事實所生『同一』債權之一部起訴者，該起訴中斷時效之效力及於其餘債權額（參見史尚寬著民法總論第 601 頁），故上訴人於本院擴張追加上開請求，並無罹於消滅時效之問題」（詳原證 47 及原證 48）。本件擴張訴之聲明，既係基於同一原因事實（即侵權行為所生損害賠償請求權），且已為債權一部之請求，原告 94 年 12 月 23 日擴張訴之聲明即應未罹於時效。

(丙)且縱認侵權行為損害賠償請求權罹於消滅時效（原告否認之，此僅為論述所需而為之假設語氣），然「損害賠償之義務人，因侵權行為獲利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人」民法第 197 條第二項訂有明文，故原告仍得基於不當得利請求權請求被告返還其所受之利益，至為明確。且不論是基於侵權行為請求權或不當得利請求權，本件請求之基礎事實係屬同一，故原告業於 95 年 10 月 25 日依民事訴訟法第 255 條第 1 項之規定，追加「不當得利」為本件之請求權基礎，且原告請求之基礎事實同一，並不妨礙被告之防禦及訴訟之終結。

8. 爭點五：請求權基礎與被告之侵權行為態樣

(1)請求權基礎：

「物品專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口該物品之權。」、「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之」、「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。」、「損害賠償之義務人，因侵權行為獲利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人」現行專利法第 56 條、第 84 條第 1 項，民法第 185 條、及民法第 197 條第 2 項訂有明文。

(2)被告之侵權行為態樣：

❶被告至少在台灣境內從事「販賣」、「使用」及「販賣之要約」等三種侵害原告專利之行為態樣，此三種行為態樣之任何一者，均為專利法所禁止，合先敘明。

❷被告之「販賣」系爭產品行為：

(甲)按依系爭產品之特性，被告「販賣」系爭產品之行為須在台灣進行，方能完成。蓋系爭產品乃極為精密複雜之製造液晶顯示器面版的高科技設備，此等高科技設備之買賣與一般電冰箱、冷氣機等消費性產品截然不同。一般電冰箱、冷氣機等消費性產品皆為固定規格之產品，消費者只要買回家就可以自行安裝使用，故其買賣行為通常在交貨時即已完成並付清價金；然高科技設備並非消費性產品，尤以像系爭產品此等精密設備，根本無法將整個成品組裝完成，一次交貨，而必須以零組件方式拆開運送，到目的地後再行組裝，且只有生產該設備之製造商知道如何組合、安裝、設定、測試、技術指導、操作訓練及維修該設備，故此種高科技設備之買賣合約中皆會要求出賣人（製造商）必須在買受人之廠房中進行該設備之安裝、設定、測試及維修等行為。因此，該等安裝、設定、測試及維修等行為皆為契約中出賣人（製造商）之重要義務，在出賣人確實履行該等義務完畢之前，買受人不會付清價金，買賣行為根本尚未完畢。職是，就系爭產品為安裝、設定、測試、技術指導、操作訓練及維修等行為亦當然構成販賣行為之一部分，故被告顯然在台灣「販賣」系爭產品而構成侵害系爭專利，至為明確。

(乙)換言之，此種高科技設備之販賣行為係指出賣人必定要履行製造、交運、安裝、設定、測試、技術指導、操作訓練及維

修等行爲，故被告辯稱依 FOB 之海運條件當機器於韓國港口跨越船舷時其買賣行爲即已履約完畢云云，顯無可採。

㉑ 被告在台灣針對系爭產品爲「販賣之要約」之行爲，亦屬侵害系爭專利之行爲

(甲)由被告在台灣設有業務據點及其實際上在台灣銷售系爭產品等事實，業足以證明被告在台灣從事「販賣之要約」之行爲。蓋查，被告英屬蓋曼群島商周星科技公司乃被告韓商周星工程公司之子公司，其在台灣設有辦公室（位於新竹縣北市十興里縣政二路 424 號 2 樓），該辦公室實際上即被告在台灣之業務據點，被告負責銷售之業務人員利用此業務據點經常性的與奇美公司及其他製造液晶顯示器之台灣廠商聯繫，故被告在台灣設此業務據點之目的主要即在支援其在台灣進行推銷系爭產品之行爲，換言之，此據點係爲便利被告在台灣對其台灣客戶及潛在客戶進行販賣之要約而設。

(乙)此外，由被告英屬蓋曼群島商周星科技公司認許事項變更表上所載「在中華民國境內所營事業項目」包括精密儀器批發業、事務性機器設備零售業、電子材料批發業、電子材料零售業、精密化學材料批發業、精密化學材料零售業、資訊軟體批發業、資訊軟體零售業及國際貿易業等（原證 42 號），亦足以證明被告在台灣之業務據點主要係爲支援其在台灣進行推銷系爭產品之行爲，蓋所謂批發、零售、國際貿易等，皆明確顯示其在台灣主要之營業行爲即是針對台灣之客戶與潛在客戶爲關於產品之「販賣」與「販賣之要約」等行爲，俾利推銷系爭產品。抑有進者，從被告英屬蓋曼群島商周星科技公司多位駐台人員名片上之職稱載明「業務經理」（原證 43 號）等頭銜亦明確顯示，該公司人員在台主要就是從事「販賣」與「販賣之要約」等業務推廣之工作。

(丙)以被告將系爭產品賣給奇美公司爲例，此項銷售行爲之完成，雙方必須先就標的物內容（包括技術細節）及價金達成合致，而因系爭產品係屬精密之高科技設備，其銷售方式係由出賣人主動先向買受人詳細介紹產品之內容及各項技術細節，買受人在瞭解產品之內容後，才能評估是否符合本身之需求，進而考量價金是否合理，最後再決定是否要購買。因此，很明顯的，必定先由出賣人（即被告）發出要約之通知（即爲販賣之要約），嗣經買受人（即奇美電子公司）之承諾後，買賣契約始得正式成立。以本件而言，據被告網站上所公布之資料（原證 5 至 7 號）以及韓國財務監督服務 (Financial Supervisory Service) 網站於 2003 年 6 月 2 日

、2003 年 10 月 28 日、2003 年 12 月 1 日及 2004 年 8 月 18 日所公布被告揭露之公開資訊(原證 82 至 88 號)顯示，被告確實至少業已銷售並交付奇美電子公司共 4 台之系爭機器(詳前述)，故被告顯然在台灣完成為「販賣之要約」之行爲，進而販賣系爭產品至台灣，自屬構成侵害系爭專利之行爲，彰彰甚明。

④被告過去及目前所繼續進行之行爲，包括：系爭產品之安裝、設定、測試、技術指導、操作訓練或維修等行爲確實已構成侵害專利之行爲，蓋該等行爲亦屬我國專利法第 56 條所規範之「使用」行爲：

(甲)有關係爭產品之安裝、設定、測試、技術指導、操作訓練或維修等行爲，不僅是出賣人在買賣契約中之重要義務而屬販賣行爲之一部分，且該等行爲亦屬專利法第 56 條所謂之「使用」行爲，此等安裝、設定、測試、技術指導、操作訓練或維修等「使用」行爲亦皆在台灣進行，故被告稱其在台灣並無任何專利法所規範之行爲云云，亦顯不可採。

(乙)按專利法第 56 條所規定之「製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口」，都是個別獨立之行爲，亦即只要有其一，就足以構成專利權之侵害。從法條文義可以明顯得知，從事任何一個行爲都構成侵害專利。

(丙)依我國專利主管機關經濟部智慧財產局公布之「專利侵害鑑定基準」載明：「所謂『使用』係指實現專利的技術效果之行爲，包括對物品之單獨使用或作為其他物品之部分品使用。」(請見原證 40 號：經濟部智慧財產局公布之專利侵害鑑定基準第一章第二節)，申言之，只要是「實現專利的技術效果之行爲」，即構成專利法上之「使用」行爲，其範圍相當廣泛。

(丁)有關「使用」之定義，根據 Merriam-Webster online 網路字典所揭示之定義，所謂「使用」乃包括「使運轉 (to put into action)」、「利用/ 採用 (to employ)」、「使產生效用 (to avail oneself of)」、「藉…方式使其達到預定之目的或功能 (to carry out a purpose or action by means of)」等。而我國專利法規定「使用」係屬侵害專利之行爲態樣之一，事實上與美國專利法第 271(a)條所規定「任何未經授權之製造、使用、為販賣之要約、或販賣任何有專利之發明係屬侵害專利」是相同的。因此，美國法院實務就「使用」概念之說明，應可做為我國之參考，例如：美國法院之判決先例揭示：所謂「使用」某發明乃包括修理

(repair)、測試(testing)、及實際操作展示(demonstrations)；美國最高法院在 In Aro Mfg.Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964) 案中更闡明：對一個侵害專利的折疊做棚汽車蓋進行「修理」之行爲，係屬侵害專利之行爲。相同的，美國巡迴上訴法院認爲：在某個侵害專利之產品組裝完成運送到買受人之前，針對該產品之某個零件進行「測試」之行爲，亦構成專利侵權(Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F. 2d 11, 19-20 (Fed. Cir. 1984))。此外，美國法院亦認爲：針對某個侵害專利之產品進行「實際操作展示」是一種侵害專利之「使用」行爲(Quantum Group, Inc. v. American Sensor, Inc., 48 U.S.P.Q.2d 1436, 1441 (N.D. Ill. 1998))。

(戊)就安裝、設定、測試、技術指導、操作訓練或維修等行爲之本質而言：

有關就系爭產品之安裝、設定、測試、技術指導、操作訓練或維修等行爲，都必須實際操作並使系爭機器運轉。而只要在台灣一實際操作並使系爭產品運轉，必然就會「使用」到系爭專利所涉及最關鍵之部分，即包括氣體散流盤懸置裝置的氣體散流盤組件。故當被告安裝、設定、測試技術指導、操作訓練或或維修系爭產品時，就是在「使用」系爭專利之申請專利範圍，所指包括電漿室、氣體散流盤及其懸置機構等氣體散流盤組件，蓋因該等行爲就是在操作系爭產品俾使系爭產品達到生產液晶顯示器面版之目的，即實現系爭專利所意欲結果。

(己)就客觀之事實及證據而言：

事實上，被告爲履行對奇美公司之安裝、設定、測試、技術指導或操作訓練或維修等義務，一直持續地在「使用」系爭產品。此項事實，可由原告關係企業業凱公司的客服工程師王善標所出具之陳述書所載以下內容可資爲證(原證 41 號)：

- A. 奇美電子公司第 3 廠房之無塵室中，除業凱公司之第 5 代設備外，尚有 4 台被告韓商周星工程公司所供應之第 5 代設備，此等設備係設置於業凱公司之設備對面。
- B. 奇美公司負責管理與美商業凱及韓商周星等設備供應商相關事宜之主管人員，爲薄膜科(TF section)之許如龍先生。奇美公司爲控管進出無塵室之人員，要求供應商之工程師或其他人員進入無塵室前，須先將載有進入無塵室人員數目及

各人員姓名之『每日工作許可單』交由廠區警衛簽名，始得憑單進入，且於離廠時並須將前開「每日工作許可單」交予廠區警衛留存。

- C. 韓商周星工程公司之第 1 台第 5 代設備約於 92 年 11 月間運送至奇美公司第 3 廠房，其後 3 台並陸續抵達。自韓商周星之設備抵達時起，持續有韓商周星及其關係企業英屬蓋曼群島商周星科技股份有限公司台灣分公司（以下統稱「周星公司」）之工程人員進出奇美電子公司第 3 廠房之無塵室，負責韓商周星設備之安裝、設定、維修（例如處理玻璃成品於設備上碎裂之情況、更換零件耗材等）及諮詢等事項。前述周星公司之工程人員中並包括數名韓國人，且韓國工程師出現在奇美公司第 3 廠房無塵室進行前述工作之次數甚為頻繁。一般而言，倘韓商周星之設備有任何問題，奇美公司會先聯絡周星公司之台灣工程師到廠處理，如無法解決，即有韓國工程師前來處理。
- D. 自 93 年 12 月直至 94 年 1 月 20 日為止，因韓商周星工程公司之數台設備發生問題，故約有 5 名左右之周星工程公司工程人員常態性在奇美公司第 3 廠房進行維修等工作，前開人員中 1 至 2 人為台灣工程人員，其餘為韓國人。」
- (庚)據上說明，被告所為之包括安裝、設定、測試、技術指導或操作訓練或維修等行為，確屬我國專利法第 56 條所規定之使用行為，至為明確。
9. 爭點六：原告撤回申請專利範圍第 16 項及第 18 項之主張非屬訴之變更，無須被告同意。
- (1)原告起訴時本主張系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 16 項及第 28 項，惟為簡化本件訴訟之爭點，原告業於民事準備書 26 狀撤回第 16 項及第 28 項之主張。原告此項撤回乃屬攻擊防禦方法之減縮，並無涉及訴之變更或撤回，故自無須被告之同意。
- (2)又依民事訴訟法所採當事人進行主義（處分權主義）及當事人提出主義（辯論主義）之原則，原告既已撤回申請專利範圍第 16 項及第 28 項之主張，僅就被告之系爭產品侵害原告之系爭專利申請範圍第 1 項為主張，鈞院自應僅就原告所主張之申請範圍第 1 項為審酌認定，無再就第 16 項及第 28 項為審酌。
10. 結論
- 綜上所述，原告業已證明系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第 1 項而構成侵權，故原告請求排除侵害並請求損害賠償

178,200,000 元自屬有據。請求判決如聲明所述。

二、被告之聲明及陳述：

(一)、聲明：

1. 原告之訴駁回。
2. 訴訟費用由原告負擔。

(二)、陳述：

1. 程序抗辯

(1) 程序抗辯—原告本件訴之提起已罹於時效

①查原告於 93 年 6 月 30 日提起本件訴訟，依其於起訴狀之主張：根據原證 3 號被告公司銷售型錄，被告「顯有利用原告前述 152996 號專利之情事」（原告起訴狀第 4 頁第三點之記載），是以原證 3 號文件顯係原告據以指摘被告侵害其專利之事實證據，原告根據原證 3 號文件自得知悉侵權行為存在及侵權行為人，而 2 年之專利侵權行為時效自應開始起算。

②原證 3 號第 1 頁及第 4 頁分別標示「2002.02.04」及「2002.03.18」等字樣，足徵原告於 91 年 2 月間即已知悉其於起訴狀內所指稱之專利侵權情事，鑑於原告於 93 年 6 月 30 日始提起本件訴訟，本件訴訟之提起顯已罹於 2 年時效而不合法，請逕行駁回原告之訴。

(2) 程序抗辯—原告本於侵權行為請求權所為之擴張請求，已罹於時效，請先行駁回原告擴張請求之部分；縱本院審認原告就擴張之部分，得本於追加不當得利請求權，以濟其侵權行為請求權罹於時效之結果（被告仍否認之），原告亦應以證明本件事實合於民法第 179 條之法律要件，而不得再仰賴專利法第 85 條規定請求、計算損害賠償：

①最高法院 98 年台上字第 511 號判決明稽：「次按為一部請求者，就實體法而言固得自由行使該一部債權，惟在訴訟法上乃為可分之訴訟標的，其既判力之客觀範圍仍以該起訴之聲明為限度，且祇就該已起訴部分有中斷時效之效果。從而因一部請求而起訴之中斷時效，並不當然及於嗣後將其餘殘額擴張請求之部分」（全文詳被證 54 號）。

②最高法院 96 年台上字第 500 號判決亦指出：「又按『一部請求』者，於實體法而言，固得自由行使該一部債權，惟在訴訟法上，乃為可分之訴訟標的，其既判力之客觀範圍仍以該起訴之聲明為限度，且祇就該已起訴部分有中斷時效之效果，其因『一部請求』而起訴之中斷時效，並不當然及於嗣後將其餘殘額擴張請求之部分。原審本此見解而為上訴人上開時效消滅之論斷，並無何違背法令之處」（全文詳被證 55 號）

；同旨參見最高法院 94 台上字第 2334 號判決，詳被證 56 號；最高法院 94 台上字第 1677 號判決，詳被證 7 號；最高法院 91 台上字第 629 號判決，詳被證 8 號；最高法院 88 年台上字第 1908 號判決，詳被證 9 號）。

- ④查原告於起訴狀自承其於 92 年 5 月間即已知悉被告有所謂之侵權行為（原告起訴狀第 5 頁末 2 行參照），則原告縱於起訴狀內表明本件為一部請求，其亦應於知悉侵權行為 2 年後，就未請求之他部為擴張聲明，否則未請求之他部，依前揭最高法院慣行之見解，即已罹於時效。然被告遲至 94 年 12 月 23 日始為擴張之聲明，其擴張請求之部分，顯已罹於時效，其訴之擴張為不合法。
- ④退步言之，縱認原告於 92 年 5 月間尙未能知悉侵權行為人及侵權行為事實，2 年時效尙未起算（被告仍否認之），原告於起訴狀內自承其於 92 年 5 月間即已知悉被告將與奇美電子公司就系爭機器進行交易，因此原告乃於 92 年 10 月間寄發警告信函予奇美公司（詳被證 10 號），要求奇美公司尊重原告之專利權，因此原告不僅於 92 年 10 月間已知悉有所謂之侵權行為，尙寄發警告信予被告之交易相對人（即奇美公司），要求渠等尊重原告之權益，顯見原告於 92 年 10 月間確已知悉其於本件所主張之侵權行為，其於 94 年 12 月 23 日所為之擴張，當非適法。
- ⑤其後，原告委託交通大學科技法律研究所所製作之「專利侵害鑑定報告」（詳參檢附於起訴狀之原證 4 號），係於 92 年 12 月 20 日發表，由於交通大學係原告私自委任製作鑑定報告之單位，原告於 92 年 12 月 20 日之前，必已提供交通大學完成鑑定所需之資料，並與交通大學反覆討論該報告之內容，甚或對於交通大學完成前揭報告前之初稿，提出修改之方向或建議，故原告於 92 年 12 月 20 日之前，必然早已知悉該鑑定報之所謂專利侵權之結果，則原告遲至 94 年 12 月 23 日始為訴之擴張，其訴之擴張當已罹於時效。
- ⑥另縱認原告於 92 年 12 月 20 日之前，未能知悉侵權行為及侵權行為人之存在（被告仍否認之），其於交通大學發表該份報告之日（即 92 年 12 月 20 日），亦應已無藉口再主張其對於侵權行為之存在無所知悉，則其怠於 94 年 12 月 23 日始為訴之擴張，無論如何其訴之擴張不可能為適法之擴張。
- ⑦最後根據行政院公平交易委員會（以下簡稱「公平會」）於 93 年 12 月 8 日對於奇美公司員工李志毅所製作之訪談記錄，當李志毅被詢及：「請說明貴公司於 92 年 12 月 23 日接獲美

商業凱科技股份有限公司台灣分公司業務副理蔣邦元先生電話通知之情形？」，李志毅告以：「本公司於 92 年 12 月 23 日接獲美商業凱科技股份有限公司台灣分公司業務副理蔣邦元先生電話通知，指稱渠（按：即係指原告，詳後述）將對周星公司（按：即本件被告）採取法律行動」（公平會製作之陳述記錄，詳被證 11 號）。查美商業凱科技股份有限公司係原告之關係企業，該公司於 92 年 12 月 23 日通知奇美公司，代原告預告奇美公司指稱將對被告採取法律行動，而該所謂之法律行動，即係原告於 92 年 12 月 24 日（即 92 年 12 月 23 日打完電話之翌日）對被告所提起之假處分聲請（假處分聲請狀，詳被證 12 號），原告欲以此限制被告與奇美公司間之正常商業活動，且原告當時於提出假處分聲請時，亦曾提出本件原證 4 號 交通大學出具之鑑定報告作為佐證，顯見原告至遲於 92 年 12 月 23 日（即其關係企業打電話予奇美公司時）之際，絕對再無藉口推卸其不知悉本件指涉之侵權行為及侵權行為人。按專利法第 84 條第 5 項有關 2 年時效之規定，係以「自請求權人知有行為及賠償義務人時」起算，而非以月或年始日為起算點，依民法第 121 條第 2 項規定：「期間不以星期、月或年之始日起算者，以最後之星期、月或年，與起算日相當日之前一日，為期間之末日」。是以原告既已於 92 年 12 月 23 日知悉被告有所謂侵權行為，則其 2 年時效之末日應為 94 年 12 月 22 日，恰為原告為訴之擴張之前一日，足證原告本件所為訴之擴張，無論如何必屬違法。

㉑綜前，本件訴之提起既已罹於時效，則原告訴之提起已非適法，遑論其訴之擴張之適法性。退步言之，縱認本件訴之提起未罹於時效（被告仍否認之），依最高法院慣行之見解，一部請求時效中斷之效力，不及於未請求之他部，故原告於本件起訴時未請求之他部，仍受 2 年時效之限制。查被告已提出充分佐證，論證原告分別於：1) 92 年 5 月間；2) 92 年 12 月 20 日之前；3) 92 年 12 月 20 日；4) 92 年 12 月 23 日，知悉所謂之侵權行為人及侵權行為事實，然由於原告遲至 94 年 12 月 23 日始為訴之擴張，其訴之擴張無論依被告前揭任何一種佐以實據之主張，均已罹於 2 年時效，其訴之擴張殆無任何合法之可能。

㉒原告雖以追加民法第 179 條不當得利之規定以為本件之另一請求權基礎，惟姑不論該等訴之追加是否合於民事訴訟法之規定或是否為本院所允准，就法律要件之成立、損害賠償數額之計算及舉證而言，民法之不當得利與專利法之侵權行為

乃容有截然不同之規範。被告謹分項說明：

- (甲)專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定就損害賠償之計算，設有不同於民法且有利於專利權人之特別規定，故原告即係本於系爭條款據以主張及計算本件損害賠償之數額（詳參 99 年 2 月 3 日原告準備書 21 狀第 2 頁第 1 行，原告係逕以被告系爭產品之數量及銷售額直接作為其受損害之數額）。
- (乙)惟若本於民法第 179 條規定請求不當之得利，根據不當得利之規定，原告必須舉證證明：1) 被告受有利益；2) 原告受有損害；3) 受利益與受損害之間有因果關係。則根據原告之主張：「系爭產品之市場亦有其他競爭對手，故被告少賣一台系爭機器並不當然等於原告就會多賣一台系爭機器（即「產品替代率」之問題）」（原告 94 年 10 月 11 日民事陳報狀第 7 頁倒數第 6 行），兩造之間就系爭設備業務之消長，根本不具任何連結性或法律上之因果關係，姑不論原告得否證明其受有損害或被告受有利益，依原告前揭主張，原告既已自行否認兩造之間業務之消長具有因果關係，則本件事實已無可能該當不當得利之要件，縱認原告於程序上本於不當得利之請求權所為訴之追加為合法，原告亦無從證明被告之行爲該當不當得利之要件（基於其所自承之所謂產品替代率之說詞）。
- (丙)原告起訴時僅請求新台幣 5 百萬元，其餘俱為擴張之請求。如本院審認本件之起訴為合法，則原告就五百萬元之部分或得本於專利法之規定為主張；惟就超過五百萬之擴張請求部分，則必須依不當得利之規定為證明及主張，依前揭原告自行之說詞，則本件事實殆無可能該當不當得利之要件。
- (丁)簡言之，縱本院審認原告訴之提起未罹於 2 年時效且原告不當得利訴之追加為合法，本件所餘爭執亦僅為原告所受損害是否達於 5 百萬之譜爾，任何超過此數之爭執俱無審究之法律上實益。
- (3)程序抗辯—被告於中華民國領域並無進口、製造、為販賣之要約或銷售系爭機器之行爲，原告專利權之權能既無對被告據以主張之可能性，原告對被告提起本件訴訟，無待鈞院實質審究，即已構成顯無理由之訴訟
- ①根據專利法之屬地主義及專利法第 56 條第 1 項之規定，原告就其專利權，於中華民國境內專有「排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權」。因此原告專利權之權利範圍，就地域而言，限於中華民國領域之內，就權能而言，限於排除他人進口、製造

、為販賣之要約或銷售專利物品之行爲。是以除非原告能夠舉證證明被告於我國領域內有前揭行爲，其提起本件訴訟始符合民事訴訟法第 249 條第 2 項「在法律上非顯無理由」之要件，本件亦始有繼續審理及調查是否構成專利侵權之必要。

- ②查原告指稱所謂侵權之系爭機器，係在韓國製造，並由奇美電子公司自行由韓國辦理進口，系爭機器之所有權，依 FOB 之海運條件，於系爭機器於韓國之港口跨越船舷時，即歸屬奇美公司所有，被告自始自終均未於我國領域內就系爭機器有任何進口、製造、為販賣之要約或銷售之行爲，此等機器製造、銷售及進口之流程，深信原告亦知之甚稔而無爭執。此觀之原告所提出被告銷售系爭設備之所謂證明，俱為韓文之公告資料自明（原證 82-88 參照）。若所有系爭設備之銷售資料俱為韓文公告（即原告所提出之原證 82-88 ），所有之製造及進口行爲亦與我國領域無關，則本件於我國是否有審判權及管轄權，均非無疑。
- ③原告雖提出所謂美國之法院見解主張被告於台灣就系爭設備亦有使用行爲云云，惟姑不論原告所提出之所謂美國法院見解之確實性、憑信性，甚或是否仍為現行有效之見解，被告乃係設備製造商（製造地在韓國），設備之使用者實為向被告購買設備之客戶，故若原告無從進一步提出實證，證明被告確有所謂使用系爭設備之行爲，則單憑幾紙來源及法律地位不明之所謂美國見解，即欲片面主張被告在台灣有所謂法所禁止之使用行爲，原告之主張及推論未免過於空泛而乏實據。原告不查，明知其對於被告並無專利法所授與之排除權能，仍擅予提起本件訴訟，本件訴訟即顯無理由。
- ④實則，單以原告於起訴狀所描述之事實而言，被告所有與系爭設備有關之行爲均發生在韓國，與本件有關之所有聯繫因素俱指向韓國，唯一一事實上之聯繫因素（而非法律上之聯繫因素）即為購買之客戶在台灣（即奇美公司），原告明知於此，惟為藉由本件訴訟之提起而影響客戶購買設備之商業決定，仍不惜執意於我國起訴，益證其明知本件自始欠缺審判權及管轄權。
- ⑤原告刻意選擇於台灣起訴，而非至聯繫因素較密切之韓國進行訴訟之另一重要原因，即為系爭專利之韓國對應案，其經核准之申請專利範圍遠遠小於系爭專利之權利範圍，致其難於基於韓國之對應專利主張任何權利（此部分技術細節詳後述）。故原告如未能舉證證明被告於我國領域內確有前述行

為，本件即已無進一步審理之必要。

2. 專利無效抗辯

(1) 系爭專利第 16 項及第 28 項所定義之「可彎曲部分」欠缺在氣體散流盤「之上」的要件，以致於第 16 項及第 28 項無從與證據 3 作區別而應屬無效：

- ① 查原告已多次自承系爭專利與證據 3 之區別，在於系爭專利懸置機構之可彎曲部份在氣體散流盤「之上」，而證據 3 之可彎曲部份在氣體散流盤「之內」，此部分已有歷次審判筆錄可稽（相關筆錄出處詳後述）。
- ② 惟查，系爭專利第 16 項及第 28 項就懸置機構之「可彎曲部分」及其與氣體散流盤之關係，並無定義「之上」、「之下」或「之內」之技術特徵，故系爭專利第 16 項及第 28 項與證據三之技術特徵毫無區別，明顯屬於習知之公共知識，與得據以主張權利之專利顯有區別，故第 16 項及第 28 項自應屬無效，且亦無從作為論證侵權之基礎。
- ③ 原告代理人雖於本院 97 年 4 月 3 日庭訊時，當庭宣稱原告亦曾就系爭專利第 16 項加入「之上」之更正要件，惟遭智慧財產局所拒云云。惟查，原告計三次修正系爭專利之申請專利範圍，根據原告專利代理人所具名提呈之文件顯示，原告從未於第 16 項及第 28 項試圖加入「之上」之要件（原告第一次申請更正之文件，詳被證 1 號；第二次申請更正之文件，詳被證 6 號；第三次更正之文件，詳原證 45 號）。此等三份原告自己具名之文件，不僅證明原告代理人於前次庭訊時所言有虛，亦再次證明原告反覆再三所稱一系爭專利與證據三之差別在於懸置機構之「可彎曲部分」在氣體散流盤「之上」之特徵，在第 16 項及第 28 項完全不存在。

(2) 原告據以主張侵權之系爭專利第 1 項、第 16 項及第 28 項等申請專利範圍無效一與專利無效抗辯有關之申請專利範圍解釋一有關「之上」之爭議。

① 系爭專利第 1 項、第 16 項及第 28 項之關係，依智慧局原舉發審定之見解，即屬自相矛盾，僅憑此等自相矛盾之論理及認定，第 1 項、第 16 項及第 28 項與證據三即無從區別，而不具可專利性：

(甲) 智慧局 N01 舉發審定書審認系爭案第 1 項與證據三不同，系爭案具可專利性之理由，主要係因：「證據三為美國專利 US0000000，（中略），其做為熱隔絕及緩衝熱膨脹產生之應力之原理固然與系爭專利利用可彎曲之懸置機構 24 以達成熱阻隔及緩衝熱膨脹產生之應力之原理相同，但兩者之結構

並不相同。證據三兩個深槽 140 及 142 係設於面板底部邊緣，其長度受限於噴灑頭之厚度。系爭專利懸置機構係設於背壁及氣體散流盤之上，結構明顯不同，其有更大的彈性來做設計以緩衝較大之熱膨脹應力」（智慧局原舉發審定處分第 5 頁，詳參原告 96 年 8 月 3 日附件 2 號）。

(乙)智慧局前揭認定，得以下列圖示說明，下圖左為系爭專利之第 10 圖，其可彎曲之懸置機構（24）標示為紅色長條部分，藍色部分則為氣體散流盤（20）之孔洞。下圖右為證據三之第 2 圖，證據三之可彎曲部分為紅色圓圈所標示之類似「蛇腹」部分，因系爭案之可彎曲部分在氣體散流盤之上，而證據三之可彎曲部分在氣體散流盤側邊（或稱下方），因此智慧局 N01 之審定書認為兩者有所區別，而審認系爭專利並非無效。

(丙)事實上，系爭專利第 1 項原本並無「之上」之要件，第 1 項有關「之上」之要件，係原告於系爭專利經核准後申請更正時所加入的，因為智慧局原處分審認：系爭案第 1 項「原敘述『該第一端與第二端之間的至少一可彎曲部分』之文義實際包括彎曲部分可能在『氣體散流盤旁邊那一段』（或稱下方）或『氣體散流盤之上的部分』或『前兩者之組合』，更正將彎曲部分的位置限縮為『氣體散流盤之上的部分』，符合『申請專利範圍之限縮』之規定」（原處分第 3 頁第 8 行，詳參原告 96 年 8 月 3 日附件 2 號）。

(丁)智慧局原處分前揭認定，得以下圖說明。根據 N01 原處分，智慧局認為第 1 項有關懸置機構：「該第一端與第二端之間的至少一可彎曲部分」之文義，在加入「之上」之更正前，解釋上包括三種可能（即氣體散流盤之上、之下、及兩者之組合）；加入「之上」之更正要件後，則得以排除「之下」及「組合」之可能性，而得與證據三區別。因此智慧局認為第 1 項加入「之上」之要件因屬「限縮」而合於專利法第 64 條關於更正之規定，並得藉此與證據三區別。

(戊)惟查，系爭專利第 16 項及第 28 項等關於「懸置機構」可彎曲部分之文義，俱無「之上」之要件，依照智慧局自行建立之前揭邏輯，系爭案第 16 項及第 28 項之技術內容，解釋上包括三種可能，勢將無從與證據三之技術內容區別，而致渠等之技術為證據三所揭露，不具可專利性。詎料，智慧局 N01 原處分於第 16 項及第 28 項之審查意見竟稱：「理由同申請專利範圍第 1 項所述（即理由（五）之 1 ），證據三至證據五尚難證明」系爭案不具可專利性（第 16 項之敘述參見原處分第

6 頁倒數第 2 行；第 28 項參見第 7 頁第 10 行，原處分全文詳參原告 96 年 8 月 3 日附件 2 號）。

- (己)智慧局原處分既認第 1 項得與證據三區別之理由，係因第 1 項所定義之懸置機構其可彎曲部分在氣體散流盤「之上」，而且第 1 項在更正加入「之上」之要件前，有三種解釋可能，其中兩種俱為證據三所揭露（即可彎曲部分在氣體散流盤「之下」或「之上及之下」之組合），則第 1 項經智慧局認有可專利性，其關鍵理由即在於其所定義之「可彎曲部分」具有「之上」之要件。
- (庚)然系爭案第 16 項及第 28 項等申請專利範圍之文字，完全沒有「之上」之要件，此為客觀事實，不容智慧局及原告混淆，則依智慧局於審查第 1 項所自行建立之邏輯，欠缺「之上」之要件將導致「可彎曲部分」之解釋容有三種可能而無從與證據三區別，第 16 項及第 28 項將顯不具可專利性。然智慧局竟認第 16 項及第 28 項無須具備「之上」之要件，即得與證據三區別，智慧局此等認定即顯與其於第 1 項之審查意見自相矛盾，系爭專利依智慧局之 N01 舉發審查意見，即可自證其不具可專利性。
- (辛)原告明知第 16 項及第 28 項因欠缺「之上」之要件，而致悖於智慧局就第 1 項所為之認定，故乃執意主張：
- A. 「第 16 項具有與第 1 項位於該氣體散流盤『之上』相當的技術特徵，而以不同的方法來界定」，因為第 16 項具有：「該懸置機構圍繞著該進氣歧管中的區域，該區域延伸至該進氣歧管背壁與該氣體散流盤之間」之要件（參見原告 97 年 5 月 23 日準備書 10 狀第 21 頁；原告於此書狀中就第 28 項亦為相同主張）；
- B. 「智慧局已經認為我們第 16 項的用語已經明確看出懸置機構在氣體散流盤之上，就不需要再更正」、「我們還是認為系爭專利的第 16 項的其中一個特徵是懸置機構在氣體散流盤之上」（原告代理人於本院 97 年 4 月 3 日審判筆錄之陳述）；
- C. 「就我們獨立項 16 及 28 項，雖然文字上沒有加入『之上』兩個字，因為我們在 claim 當中已經載明懸置機構是環繞著進氣歧管的區域，該區域延伸該進氣歧管的背壁等等，該懸置機構所圍繞的空間區域，確實就是在位於氣體散流盤之上」（原告代理人於本院 97 年 5 月 27 日審判筆錄之陳述）；
- D. 「雖然第 16 項並未以相同文字界定『位於該氣體散流盤之上』，但第 16 項具有與第 1 項『位於該氣體散流盤之上』相當的技術特徵，而以不同的方式來界定，並且被告機關也認知

此事實」（原告 97 年 6 月 17 日於舉發行政訴訟遞呈之參加人答辯狀第 6 頁）。

(壬)查第 16 項及第 28 項之文字明明沒有「之上」之要件，原告卻欲強加「之上」之限制條件，足見原告亦明知第 16 項及第 28 項欠缺「之上」要件之結果，將與智慧局 N01 審定書自相矛盾，而使第 16 項及第 28 項自陷無效之窘境。

(癸)姑不論原告前揭說詞是否有當，第 1 項亦有「該懸置機構圍繞…」之要件，但原告為區別證據三，仍在第 1 項懸置機構的可彎曲部分申請更正加入「位於氣體散流盤之上」的要件，且智慧局亦明知第 1 項有所謂「該懸置機構圍繞…」之要件，卻仍審認第 1 項在加入「之上」之前，有三種解釋可能，足徵智慧局亦認所謂「該懸置機構圍繞…」之要件無從解讀出「之上」之意義，是以根據智慧局在第 1 項之審查意見，即可知原告此部分主張毫無可採，系爭專利第 16 項及第 28 項依智慧局就第 1 項所為之審查意見，即可自證渠等不具可專利性。根據我國專利舉發之實務，一專利之任一請求項無效，則整件專利均因之失其效力，於我國專利舉發之對象係個別請求項，而非以專利為舉發客體，鑑於系爭專利第 16 項及第 28 項因智慧局就第 1 項所為之審查意見而自證渠等無效，則整件系爭專利（包含第 1 項）亦因之而無效。

②原告代理人雖經多次自認「之上」之要件對於第 1 項、第 16 項及第 28 項之有效性具有重大意義之後，眼見第 16 項及第 28 項因明顯欠缺「之上」之文義而無從比附援引第 1 項「之上」之要件，竟又改口稱：「之上」完全不重要，欠缺「之上」之要件亦得與證據 3 區別而具專利有效性，原告說詞前後矛盾：

(甲)原告多次於不同場合及程序強調系爭專利之所以得與證據三區別而具可專利性，係因具有「之上」之要件，例如：

- A. 「申請專利範圍第 1 項相較於證據三具有可專利性，因為其揭示了該懸置機構之至少一可彎曲部分係位於該氣體散流盤之上，即位於該氣體散流盤及該進氣歧管之背壁之間」（原告 93 年 8 月 13 日提出之專利舉發答辯書第 17 頁，詳被證 32 號）；
- B. 「本案申請專利範圍第 1 項之發明係界定該懸置機構之至少一可彎曲部分位於氣體散流盤之上，因此，本案之優點為懸置機構之可彎曲部分的長度大於證據三所揭示實施例之該可彎曲薄壁之長度」（原告 93 年 8 月 13 日提出之專利舉發答辯書第 17 頁，詳被證 32 號）；

- C. 「證據三的可彎曲部分也就是 146 是在氣體散流盤的旁邊，系爭專利的可彎曲部分是在氣體散流盤的上面，兩者結構顯然不同」（原告代理人於鈞院 97 年 2 月 25 日審判筆錄之陳述）。
- (乙)由於被告明確指出第 16 項及第 28 項欠缺「之上」之要件而無從與證據三區別，智慧局隨即於 N01 舉發審定之行政訴訟改稱：「由於系爭專利申請專利範圍第 1 項更正前（被告按：即加入「之上」之前）之技術特徵內容已經足以與證據 3 區分，第 1 項得以與證據 3 區分不是因為『之上』的更正，才有所區分，故系爭專利申請專利範圍第 16、28、36 與 40 項之可專利性與『之上』的技術特徵無涉」（詳智慧局所提出之行政訴訟答辯狀第 5 頁，詳原證 67 號）。
- (丙)原告雖多次於書狀、電子簡報檔 PowerPoint 紙本及本件之審判筆錄主張第 1 項、第 16 項及第 28 項之所以能夠與證據三區別而具可專利性，係因具有「之上」之要件，然原告眼見無從合理化第 16 項及第 28 項欠缺「之上」要件之弊病，竟改口稱：
- A. 「系爭專利在更正申請專利範圍之前，本即足以與證據三區別而具有可專利性」（原告 97 年 8 月 14 日 PowerPoint 紙本第 28 頁）；
- B. 「智慧局不僅從未曾表示第 1 項得以與證據三區分是由於第 1 項的『之上』更正，事實上，智慧局頃於行政訴訟程序中再次確認並強調：『（省略，與前揭智慧局之行政訴訟答辯狀陳述相同，詳原證 67 號智慧局所提出之行政訴訟答辯狀第 5 頁）』等語，故系爭專利在更正申請專利範圍之前即足以與證據三相區別而具可專利性，至為明確」（原告 97 年 8 月 14 日準備書 12 狀第 2 頁 倒數第 7 行）；
- C. 「智慧局從未表示第 1 項得以與證據三區分是由於第 1 項『之上』更正。智慧局僅以更正後第 1 項與證據三相較，認定更正後的申請專利範圍第 1 項相較於證據三具可專利性之特徵，而作出第 1 項具有可專利性之決定。實際上，智慧局係以更正後之申請專利範圍第 1 項與證據三比較，認定第 1 項相較於證據三具有可專利性之特徵，而作出第 1 項相對於證據三具有可專利性之決定」（原告 98 年 3 月 20 日準備書 14 狀第 16 頁倒數第 3 行）。
- (丁)綜前可知，原告忽而謂：「之上」很重要；忽而謂：「之上」毫不重要；忽而謂：第 1 項更正前（即加入「之上」之前）即得與證據三區別；忽而謂第 1 項更正後始得與證據三區

分云云，其說詞前後矛盾。

- ④惟查，當被告檢附新證據（即證據二）向智慧局提出 N02 之舉發案之後，原告竟三度改口，重新主張「之上」很重要
- (甲)兩造爭執之初，原告為求鞏固系爭專利之有效性，遂於智慧局之 N01 舉發程序及鈞院之民事訴訟程序多次強調「之上」之重要性。當系爭專利之有效性似相對漸趨穩固後，原告隨即試圖擴張申請專利範圍之解釋，強調「之上」對於系爭專利有效性之認定一點都不重要，以期在侵權認定之過程爭取較有利於得出構成侵權之機會。此之所以有前揭所說明原告兩度就「之上」之要件反異其詞之過程。
- (乙)詎料，當被告檢具新證據（即證據二）向智慧局提出 N02 舉發案後，原告竟三度改口再行主張：
- A. 「經查智慧財產局於系爭專利第一次舉發案中已經認定：因系爭專利更正後之申請專利範圍第 1、16 及 28 項明示與隱含列示之技術特徵『氣體散流盤上方之可彎曲部分』（被告按：「上方」之粗體及底線係原告原有之表示方法，非被告所添附），確與被告所檢附之參考文獻有所區別且非能據此輕易完成，故對被告之第一次舉發案作成舉發不成立之審定。其後，經濟部（授權其訴願委員會決定）與台北高等行政法院在隨後之訴願與行政訴訟中亦皆以實質相同於智慧財產局之決定及判決維持智慧財產局所作成舉發不成立之審定」（99 年 3 月 24 日原告準備書 24 狀第 2 頁 第 8 行）；
- B. 「證據二與證據三均未揭露或教示系爭專利更正後之申請專利範圍第 1、16 及 28 項明示與隱含列示之技術特徵『氣體散流盤上方之可彎曲部分』」（99 年 3 月 24 日原告準備書 24 狀第 3 頁第 8 行）；
- C. 「證據三與第一次舉發中所檢附之參考文獻相同。證據三並無揭露或教示技術特徵『氣體散流盤上方之可彎曲部分』，因此，智慧財產局於第一次舉發案之審定書仍同意系爭專利更正後之申請專利範圍第 1、16 及 28 項具有可專利性，而維持系爭專利的有效性」（99 年 3 月 24 日原告準備書 24 狀第 3 頁第 12 行）；
- D. 「證據二雖為被告於第二次舉發案新引用之參考文獻，然則連被告亦未主張證據二已揭露系爭專利更正後之申請專利範圍第 1、16 及 28 項之技術特徵『氣體散流盤上方之可彎曲部分』。實際上，證據二的確沒有揭露或教示上述特徵」（99 年 3 月 24 日原告準備書 24 狀第 3 頁倒數第 5 行）；
- E. 「證據二中之分離板彎曲部 5b 完全位於分離板主體 5a 下方，

- 對之，系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項要求該懸置機構之可彎曲部分位於氣體散流盤上方」（原告 99 年 3 月 1 日 N02 舉發答辯書第 7 頁倒數第 8 行，詳參原證 81 號）；
- F. 「申請專利範圍第 1 項要求懸置機構之可彎曲部分位於氣體散流盤上方，對此證據二並無任何揭露或教示」（原告 99 年 3 月 1 日 N02 舉發答辯書第 8 頁第 13 行，詳參原證 81 號）；
- G. 「至少證據二並無揭露或教示申請專利範圍第 1 項所述之『懸置機構之可彎曲部分位於氣體散流盤上方』，因此系爭專利相對於證據二而言係具有新穎性。相反地，證據二中舉發人主張為可彎曲懸置機構之結構係位於其主張為氣體散流盤之結構的下方，而非上方」（原告 99 年 3 月 1 日 N02 舉發答辯書第 8 頁倒數第 9 行，詳參原證 81 號）；
- H. 「系爭專利申請專利範圍第 1 項明示『懸置機構具有位於該氣體散流盤之上的至少一可彎曲部分』。對之，證據二之分離板彎曲部 5b 係位於分離板主體 5a 下方…，自系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項之技術特徵『懸置機構具有位於該氣體散流盤之上的至少一可彎曲部分』獲得之優點無法直接且無歧義地自證據二之分離板彎曲部 5b 得知」（原告 99 年 3 月 1 日 N02 舉發答辯書第 9 頁第 2 行，詳參原證 81 號）；
- I. 「系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項相對於證據二與證據三之任何組合而言係具備有效性，因為證據二與證據三均無揭露或教示延伸於氣體散流盤上方之可彎曲側壁。顯而易見的是，證據二與證據三均無揭露或教示延伸於氣體散流盤上方之可彎曲側壁。既然沒有任何證據教示此項特徵，邏輯上不能認為證據二與證據三之組合可教示此項特徵，即證據二與證據三之組合並非顯然」（原告 99 年 3 月 1 日 N02 舉發答辯書第 19 頁第 1 行，詳參原證 81 號）。
- (丙)綜前可知，當被告提出證據二之新證據後，原告不僅絕口不提系爭專利更正「前」之申請專利範圍即足以區別證據二或證據三，尚且再度翻異其詞，一再、反覆及再三強調藉由「之上」之特徵區別證據二及證據三之重要性。換言之，「之上」已成為原告目前防禦專利有效性攻擊最重要之基礎及理由，系爭專利若欠缺「之上」之特徵，依照原告之邏輯及認知，將顯不足捍衛系爭專利之有效性，遑論系爭專利除第 1 項之外，第 16 項及第 28 項根本沒有「之上」之要件。
- ④原告既已自認：「之上」根本不是系爭專利得具有有效性之原因，且系爭專利更正前（即加入「之上」要件之前）之特徵即足以建立其有效性，依誠信原則及法院實務所採行之爭點

效理論（即系爭專利 N01 舉發案行政訴訟判決之認定），原告自不得再翻異其詞，重新主張以「之上」為理由捍衛其專利有效性。根據原告之準備書 24 狀，其既已自承「之上」為系爭專利區別證據二及證據三之重要特徵，而此等重要特徵已於過去之訴訟程序為其自行所捨棄，則原告無異坦承在欠缺「之上」之特徵時，系爭專利第 1 項、第 16 項及第 28 項，已為證據二、證據三或渠等之組合所揭露，而不具新穎性及進步性。

(3)原告據以主張侵權之系爭專利第 1 項、第 16 項及第 28 項等申請專利範圍無效一與專利無效抗辯有關之申請專利範圍解釋一智慧局 N01 審定書審認系爭專利具可專利性之理由在於系爭專利第 1 項、第 16 項及第 28 項申請專利範圍所稱「可彎曲部分」之範圍，不包括一般金屬之延展性；然原告卻明確表示：系爭專利申請專利範圍界定之「可彎曲」涵蓋「一般金屬之延展性」，智慧局認定系爭專利為有效之關鍵理由，竟與原告自承之解釋相左，依原告之意見，系爭專利顯已包含習知技藝（金屬一般延展性），而不具可專利性。

①智慧局於 N01 原處分第 5 頁第(五)-1-(2)節比較舉發證據三與系爭專利，並認為：「金屬材質(鋁材質)具有延展性，其於受到外力時有可能產生形變或彎曲，此故為金屬材質(鋁材質)之固有特性，亦為眾所皆知，然其必須有特定的設計方能應用及承受氣體散流盤之熱膨脹應力，換言之，在證據三或系爭專利之系統操作條件下，並非只要是鋁材質就可彎曲(尚需視其尺寸長厚比例及承受之外力)，或其彎曲程度足以緩衝該系統之熱膨脹應力」，亦即智慧局認為「一般金屬之延展性」並非系爭專利申請專利範圍第 1 項界定之「可彎曲」。

②智慧局係採納原告於 95 年 7 月 17 日提出之舉發補充答辯書的理由，於該舉發補充答辯書第 5 頁第 10-11 行中，原告特別強調：「材料具延展性並不表示該材料的最終結構必然可彎曲」（詳參被證 22 號）。

③然而，原告 96 年 11 月 20 日準備書 7 狀完全推翻其原先之主張，於該準備書 7 狀第 6 頁第 18-20 行，原告以黑體字強調：「原告於舉發答辯狀之陳述及智慧局舉發審定書意見中，均未將『一般金屬之延展性』排除於『可彎曲』之適用範圍外…」；亦即，原告完全推翻其原先之主張，而認為系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 16 項及第 28 項之「可彎曲」得涵蓋「一般金屬之延展性」的情況。

④智慧局與原告之說詞得以逐字引述之方式對比如次，顯見原告將一般金屬之延展性納入系爭專利申請專利範圍「可彎曲」之範圍，將明顯包含「眾所皆知」之習知技藝，而當然得推導出專利無效之結論：

| 原告之主張 | 智慧局之主張 |
|---|--|
| 「材料具延展性並不表示該材料的最終結構必然可彎曲」(原告95年7月17日提出之舉發補充答辯書第5頁，詳被證22號) | 「金屬材質(鋁材質)具有延展性，其在受到外力時有可能產生形變或彎曲，此故為金屬材質之特性，亦為眾所皆知」(第一次舉發案審定書原處分第5頁倒數第11行)。 |
| 「原告於舉發答辯狀之陳述及智慧局舉發審定書意見中，均未將『一般金屬之延展性』排除於『可彎曲』之適用範圍外...」(原告民事準備書7狀第6頁第18-20頁) | 「金屬材質(鋁材質)具有延展性，其在受到外力時有可能產生形變或彎曲，此為金屬材質之特性，然其必須有特定之設計方能應用及承受氣體散流盤之熱膨脹應力。換言之，在系爭專利或證據三或證據四之系統操作下，尚須視其尺寸長厚比例及承受外力而定；或其彎曲程度足以緩衝該系統之熱膨脹應力」(第一次舉發案審定書第6頁第11行)」 |

⑤被告已多次質疑智慧局於原處分既已明白表示一般金屬之延展性屬「眾所皆知」之習知技藝，則當原告主張系爭案申請專利範圍第1項、第16項及第28項等文字所稱之「可彎曲部分」，竟得以包含「眾所皆知」之習知金屬一般延展性時，原告基於何等理由主張系爭案具可專利性？原告及智慧局對於此等何以含括習知技藝（「眾所皆知」之一般金屬延展性）之系爭案得以審認為具有可專利性，迄今未能提出具體之回應與答辯。

⑥實則，誠如智慧局認定之事實（一般金屬延展性屬眾所皆知之習知技藝）及原告之主張（系爭案申請專利範圍所指之「可彎曲」包括一般金屬延展性），既然原告已自承系爭案之

技術內容包含智慧局認定之「眾所皆知」習知技藝，則僅就此而言，系爭案已無任何可專利性可言。

①進一步言之，如言詞辯論狀第 31 頁圖(系爭案第 10 圖)所示，紅色所標示之長條形金屬分別為系爭案及證據三之懸置機構，兩者皆為鋁質金屬所構成，故證據三之鋁質金屬懸置機構因具備「眾所皆知」之一般金屬延展性，當得有某種程度之彎曲性，依前揭表格所整理原告及智慧局之說詞，若智慧局及原告一方面主張證據三之鋁質金屬懸置機構(具有金屬之一般延展性)不可彎，故系爭案相對於證據三具有可專利性；一方面卻又主張系爭案之鋁質金屬懸置機構解釋上可包括一般金屬之延展性，兩相對照之下，智慧局及原告此等認定及說詞即復陷於自我矛盾之論述，而有違論理法則。

②本院於 98 年 12 月 30 日，曾當庭以書面明列五個問題，要求原告據以說明，其中一個問題指出：第 1 項、第 16 項及第 28 項「所指之『可彎曲部分』係指『結構上』的特點或是『材料上』的特性？」，原告就此覆以：可彎曲部分「不限於由『結構上』、『材料上』之特性分別或共同達成」(99 年 1 月 15 日陳報狀第 4 頁)，顯見原告迄今仍堅持系爭專利第 1 項、第 16 項及第 28 項之權利範圍應包括「『材料上』之特性」，且此等「可彎曲」尚得僅單獨藉由「材料上」之特性所達成。然如此不僅悖於原告之前於舉發答辯之辯詞：「材料具延展性並不表示該材料的最終結構必然可彎曲」(原告 95 年 7 月 17 日舉發補充答辯書的理由第 5 頁第 10-11 行，詳參被證 22 號)；亦悖於智慧局之認定：「金屬材質(鋁材質)具有延展性，其在受到外力時有可能產生形變或彎曲，此故為金屬材質之特性，亦為眾所皆知」、「其必須有特定之設計方能應用及承受氣體散流盤之熱膨脹應力」(N01 審定書原處分第 5 頁倒數第 11 行)。

③實則，智慧局在第一次舉發案舉發審定書中已明確表示「材料上」之可彎曲係屬「眾所皆知」，且系爭專利必須仰賴「特定之設計」始能達成發明之目的—承受熱膨脹應力，所謂「特定之設計」當係指「結構上」之設計而言，然原告竟仍欲將習知技藝囊括於其私權範圍之內，則單以此而言，一個將「眾所皆知」之習知技藝納為申請專利範圍之專利，實難謂其為有效。

(4)智慧局第一次舉發案審定專利舉發不成立，其中一個重要理由係因證據三未表明其懸置機構具有「可彎曲」之特徵；然被告所提出之新證據一證據二，已明確說明其懸置機構為可

彎曲，則當被告提出證據二為前案證據時，系爭專利殆無有效之可能，且原告亦無基礎再援引 N01 舉發審定書或相關訴願及行政訴訟判決以佐證其專利為有效之辯詞

①智慧局第一次舉發案舉發審定書指出：「證據三縱然使用金屬或鋁材質為懸置壁 130，但全文並未有任何說明及界定指出該懸置壁 130 係可彎曲之特徵，即無法據以設想、或由圖形目視、或認為該懸置壁 130 旁有空隙而推論該懸置壁係為可彎曲，故證據三結構係與系爭專利明顯不同，且未揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵，亦非熟悉該項技術者所能輕易完成，故證據三尚難證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性及不具進步性」（第一次舉發案舉發審定書第 5 頁倒數第 3 行，詳參原告 96 年 8 月 3 日陳報狀附件 2）。

②智慧局前揭認定除再次強調、重申系爭專利與證據三之區別在於「結構」上之差異之外，亦說明證據三之不足在於未明文說明或界定懸置機構係為可彎曲等語。

③查證據二已明文揭示其懸置機構為可彎曲，原告就此亦不為爭執，原告僅抗辯證據二之可彎曲部分在氣體散流盤之下方，而系爭專利之懸置機構可彎曲部分在氣體散流盤之上方；此觀之原告主張指出：「系爭專利申請專利範圍第 1 項明示『懸置機構具有位於該氣體散流盤之上的至少一可彎曲部分』。對之，證據二之分離板彎曲部 5b 係位於分離板主體 5a 下方…」（原告 99 年 3 月 1 日第二次舉發案舉發答辯書第 9 頁第 2 行，詳參原證 81 號），原告僅係抗辯「之上」與「之下」之差別，試圖區隔證據二所明文教示之可彎曲部分。鑑於證據二已以明文方式揭露懸置機構可彎曲之設計，則縱本於智慧局第一次舉發案舉發審定書之意見，系爭專利亦難維持有效性。

(5)原告對於證據二之答辯，均無足採

①原告主張：「證據二及證據三均無揭露或教示系爭專利更正後之申請專利範圍第 1、16 及 28 項明示與隱含列示之技術特徵『氣體散流盤上方之可彎曲部分』」。惟查：

(甲)如第二次舉發案案舉發理由書(被證 38)第 5-6 頁所述：證據 2 已揭示了「可彎曲」之懸置機構及相關技術內容；且證據 3 之圖 2 及第 3 欄第 55-56 行已揭示位於氣體散流盤「之上」之懸置機構(hanger wall 130)；證據 2 及證據 3 均屬相同之技術領域且欲解決相同之技術問題；故技藝人士自然可輕易將證據 2 所揭示之氣體散流盤外周的可彎曲部實施於

證據 3 位於氣體散流盤(showerhead 102)「之上」之懸置機構(hanger wall 130)；遑論原告囿於誠信原則及爭點效理論之拘束，本不得再行以「之上」與否作為區別系爭專利與證據二之理由，因此，相較於證據 2 與證據 3 之「結合」，系爭專利不具進步性。

(乙)系爭專利審定當時專利法第 20 條第 2 項規定：「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」。

(丙)系爭專利審定當時專利審查基準第 1-2-19 頁規定：熟悉該項技術者「係指虛擬一具有申請專利當時知道該發明所屬技術領域之既有技術及知識之人，其可用研究、開發等一般技術手段(指依據既有之技術或知識之基礎，經由邏輯分析、推理或試驗而得之技術手段)，並發揮一般創作能力，例如：選擇材料或變更設計，使當時該發明所屬技術領域之技術水準，化為其本身之知識的人而言」。依據前述分析及專利法和審查基準相關規定，熟悉本項技術者，係指可依據證據 2 及證據 3 既有之技術或知識之基礎，經由邏輯分析、推理或試驗，並發揮一般創作能力，例如：選擇材料或變更設計，而輕易完成系爭專利之發明。因此，相較於證據 2 與證據 3 之「結合」，系爭專利不具進步性。

(丁)原告並不否認證據 2 已揭示了「可彎曲」之懸置機構，僅一再強調系爭專利所界定的「之上」為顯著之差異。關於「之上」對於系爭專利之實質效益，如智慧局於系爭專利 N01 舉發案審定書第 5 頁之說明：「證據三兩個深槽 140 及 142 係設於面板底部邊緣，其長度受限於噴灑頭之厚度。系爭專利懸置機構係設於背壁及氣體散流盤之上，結構明顯不同，其可有更大的彈性來做設計以緩衝較大之熱膨脹應力。」；亦即，智慧局認為系爭專利該項技術特徵(「之上」)實質上為懸置機構之可彎曲部分不受限於氣體散流盤之厚度，而可以有較大的可彎曲長度以吸收氣體散流盤之熱膨脹應力。

(戊)證據 2 圖 2 所示之懸置機構之可彎曲部分亦不受限於氣體散流盤之厚度，且同樣可以有較大的可彎曲長度以吸收氣體散流盤之熱膨脹應力；證據 2 圖 2 所示之結構及相關說明，已揭示了實質相同的技術手段並達成實質相同的技術功效，與系爭專利申請專利範圍第 1 項之界定並無實質不同。況且，證據 3 之圖 2 及第 3 欄第 55-56 行已揭示位於氣體散流盤(showerhead 102)「之上」之懸置機構(hanger wall

130)，相較於證據 2 及證據 3 之揭示，系爭專利申請專利範圍第 1 項完全不具進步性。

㉒原告主張：「證據二中，分離板主體 5a 接收來自電漿室 2 之電漿。電漿成分流過分離板主體 5a 而至反應室 3 中之基板 S。相反地，系爭專利申請專利範圍第 1 項之『氣體散流盤』接收來自『氣體』進氣歧管中一區域之氣體，而非電漿」。惟查：

(甲)系爭專利與證據 2 均是關於電漿反應室，均是利用散流盤將電漿態之反應氣體噴灑在基板上；技藝人士均知「電漿態之氣體」又稱為「電漿氣體(plasma gas)」；於智慧局網站之「本國專利技術名詞中英文對照詞庫」中，可查得「電漿氣體」與「plasma gas」的中英技術名詞對照，且其出處包括國立編譯館、博碩士論文、專利英譯等；顯見，「電漿氣體」亦是氣體的一種型態；原告強將「氣體激發後形成的電漿」視為不同於「氣體」的物質，與事實不符。

(乙)系爭專利說明書第 7 頁第 16-18 行載明：「利用一個一般的真空幫浦會保持在反應室內部一定程度的真空，且從反應室經過一環狀排出縫(annular exhaust slit) 42 排出製程氣體及反應物質」；系爭專利說明書亦將所排出之「電漿氣體」稱為「製程氣體」，顯見系爭專利說明書亦認為「電漿氣體」為「氣體」。此外，證據 2 第[0019]段載明：「反應容器 1 之下部壁設有連接於排氣裝置(未圖示)之排氣口 13。」；證據 2 亦明確將電漿氣體排出口稱為「排氣口」，明確表示「電漿氣體」亦是氣體。

(丙)不論反應氣體是在通過氣體散流盤之前就形成電漿氣體，還是通過氣體散流盤之後才形成電漿氣體，與系爭專利所欲解決之技術問題(亦即，氣體散流盤之熱膨脹)無關，亦與系爭專利解決問題之技術手段(亦即，可彎曲之懸置機構)無關。縱使系爭專利與證據 2 有此一差異，此差異點並非系爭專利「突出之技術特徵」或「顯然的進步」，無法使系爭專利具有進步性。

(丁)更何況，證據 3 早已揭示與系爭專利完全相同的做法(亦即，反應氣體是在通過氣體散流盤之後才形成電漿氣體)，可詳見證據 3 第 1 欄第 44-48 行及第 2 欄第 8-13 行。顯見原告所爭執之差異點為習知技術，早已被證據 3 所揭示。

㉓原告主張稱：「系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項與證據二間之結構差異相當重要，因為其與這些部件之功能的根本差異有關。證據 2 之分離板主體 5a 為電漿室之出口，對之，

系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項之氣體散流盤為形成電漿之區域的入口」，惟查：

- (甲)如前所述，系爭專利與證據二均是關於電漿反應室，均是利用散流盤將電漿態之反應氣體噴灑在基板上；不論反應氣體是在通過氣體散流盤之前就形成電漿氣體，還是通過氣體散流盤之後才形成電漿氣體，氣體散流盤和基板之間均為電漿反應室或電漿反應區域。證據二之分離板主體 5a（等同於氣體散流盤），係作用為電漿反應室或電漿反應區域之入口；系爭專利之氣體散流盤亦作用為電漿反應室或電漿反應區域之入口；二者並無不同。
- (乙)如前所述，不論反應氣體是在通過氣體散流盤之前就形成電漿氣體，還是通過氣體散流盤之後才形成電漿氣體，與系爭專利所欲解決之技術問題（亦即，氣體散流盤之熱膨脹）無關，亦與系爭專利解決問題之技術手段（亦即，可彎曲之懸置機構）無關。縱使系爭專利與證據 2 有此一差異，此差異點並非系爭專利「突出之技術特徵」或「顯然的進步」，無法使系爭專利具有進步性。
- (丙)更何況，證據 3 早已揭示與系爭專利完全相同的做法（亦即，反應氣體是在通過氣體散流盤之後才形成電漿氣體），可詳見證據 3 第 1 欄第 44-48 行及第 2 欄第 8-13 行。顯見原告所爭執之差異點為習知技術，早已被證據 3 所揭示。
- ④原告主張稱：「證據二缺少申請專利範圍第 1 項所述之『背壁』」，惟查：被告所提之第二次舉發案舉發理由書（被證 38）第 9 及 10 頁已詳細說明：「證據 2 圖 1 及圖 2 所示之構件 1、構件 6、及構件 4 均為電漿室壁的一部分，且確實揭示系爭專利請求項 1 對於「背壁」所載明之全部技術特徵，即：…」、「證據 2 圖 1 及圖 2 明確揭示：證據 2 前述之構件 1、構件 6、及構件 4 構成電漿室 2 之電漿室壁；雖然證據 2 將電漿室壁再細分為各個構件，然而其組合完全對應系爭專利請求項 1 之「背壁」，並無實質不同。此外，「背壁」的具體結構並非系爭專利之技術特徵，亦未界定於系爭專利之請求項中」、「再者，證據 3 亦已揭示系爭專利請求項 1 中「背壁」之全部技術特徵…」。顯見原告所爭執之差異點為習知技術，早已被證據 3 所揭示。
- ⑤原告主張稱：「申請專利範圍第 1 項之詞彙『圍繞』之清楚定義為所圍繞之區域必定在懸置機構徑向內側。相反地，證據二之電漿室 2 與其每一部分在分離板彎曲部 5b 上方且徑向外側」，惟查：

- (甲)「圍繞」之區域在懸置機構徑向內側，或在分離板彎曲部 5b 上方且徑向外側，與系爭專利所欲解決之技術問題(亦即，氣體散流盤之熱膨脹)無關，亦與系爭專利解決問題之技術手段(亦即，可彎曲之懸置機構)無關。縱使系爭專利與證據 2 有此一差異，此差異點並非系爭專利「突出之技術特徵」或「顯然的進步」，無法使系爭專利具有進步性。
- (乙)況證據 3 早已揭示與系爭專利完全相同的做法(亦即，懸置機構(hanger wall 130)所圍繞之區域在懸置機構徑向內側)，可詳見證據 3 之圖 2。顯見原告所爭執之差異點為習知技術，早已被證據 3 所揭示。
- (丙)系爭專利第 1 項並未界定：「圍繞」之區域在懸置機構徑向內側；此外，由系爭專利第 1 項最後 4 行之敘述可知：該被圍繞之區域，是由背壁、氣體散流盤、及懸置機構所圍起來之區域；系爭專利第 1 項所界定之被圍繞之區域，實質等同於證據 2 之背壁(證據 2 圖 1 及圖 2 所示之構件 1、構件 4 及構件 6 之組合)、氣體散流盤(分離板本體 5a)、及懸置機構(分離板彎曲部 5b)所圍起來之區域；二者實質上相同。

㉟原告主張稱：「由於證據二與證據三基本上具有不同結構、不同功能與目的，熟悉該項技術者並沒有理由將其結合」，惟查：

- (甲)原告之主張與事實不符，如舉發理由書(被證 38)第 3-6 頁所述，證據 2 第[0001]段揭示其關於電漿處理裝置，證據 3 亦關於電漿處理裝置(證據 3 第 1 欄第 5-9 行)與證據 2 屬於相同之技術領域；證據 2 第[0007]段揭示其所欲解決之問題為分離板因為熱擴散與熱收縮而導致的問題，且證據 3 第 2 欄第 57-59 行亦已揭示欲解決熱膨脹應力造成氣體散流盤扭曲之問題；既然證據 2 及證據 3 均屬於相同之技術領域且欲解決相同之技術問題，技藝人士自然可輕易將證據 2 所揭示之氣體散流盤外周的可彎曲部實施於證據 3 位於氣體散流盤(showerhead 102)「之上」之懸置機構(hanger wall 130)。
- (乙)原告並無法舉出證據 2 與證據 3 有何結構、功能、或目的上之不同。原告之主張無理由。

3. 申請專利範圍解釋

- (1)本件解釋申請專利範圍之關鍵問題—「可彎曲」之懸置機構得否為「完整而不中斷的設計」？系爭專利之「可彎曲」懸置機構是否應切為四片？何以系爭專利韓國對應案之懸置機

構俱為「四片」或「多片」？此俱為原告所不可迴避之問題，此一爭議一旦釐清，侵權分析之答案即已同時得出

- ①系爭專利第 1、第 16 及第 28 等三個獨立項關於「懸置機構」之定義如次：
 - (甲)第 1 項：「一懸置機構有一第一端、一第二端、及該第一端與該第二端之間且位於該氣體散流盤之上的至少一可彎曲部分」（系爭專利 95 年 12 月 25 日申請專利範圍更正本，詳原證 45 號第 25 頁）。
 - (乙)第 16 項：「一懸置機構有一第一端、一第二端、及該第一端與該第二端之間的至少一可彎曲部分」（系爭專利 95 年 12 月 25 日申請專利範圍更正本，詳原證 45 號第 29 頁）。
 - (丙)第 28 項：「一懸置機構具有四片側壁，其中各側壁有一第一端、一第二端以及一可彎曲方形片延伸於該第一端與該第二端之間」（系爭專利 95 年 12 月 25 日申請專利範圍更正本，詳原證 45 號第 33 頁）。
- ②前揭申請專利範圍中，第 1 項與第 16 項之差別在於：第 1 項有「位於該氣體散流盤之上」的要件，第 16 項則無。另第 1 項及第 16 項兩者，與第 28 項之差別在於：第 28 項之懸置機構界定為「四片」，第 1 項及第 16 項則範圍顯無予以界定。
- ③系爭專利之發明目的在於其：「包含一穿透之氣體散流盤，並以一可彎曲式側壁懸吊住該側壁中，且此側壁中可以容忍氣體散流盤的熱擴散或熱收縮，本發明之優點在於避免因為熱擴散與熱收縮而導致氣體散流盤的斷裂與扭曲」（系爭專利 90 年 1 月 16 日說明書公告本第 3-4 頁，詳參原證 4 號）。
- ④依言詞辯論意旨狀第 42 頁圖所示，有孔洞的部分即為「氣體散流盤」，由於：「在電漿化學蒸汽沈積製程中，用於氣體散流盤的溫度至少為 200 °C，而較佳為 250 至 325 °C，最佳為 300 °C」（參見原證 4 號系爭專利說明書第 23 頁第 2 行），因此氣體散流盤自然會因熱膨脹而產生體積擴大的現象，而導致扭曲或斷裂。
- ⑤系爭專利說明書指出：「在已揭露之較佳實施例中，基材 14 與散流器 20 均為方形。即使可彎曲側壁 24 為單一完整，且有顯著方形切面的環形物，因為散流器 20 之熱導致機械擴張及收縮會在側壁角區域生成過量的應力，所以依然不希望有一完整而不中斷的設計」（參見原證 4 號系爭專利說明書第 16 頁倒數第 2 行至第 7 頁第 3 行）。
- ⑥方形散流器中，「完整而不中斷」致無法避免「角區域應力」的問題，得圖示如言詞辯論意旨狀第 42 頁。

- ⑦方形散流器中，「不完整而中斷」，可避免「角區域應力」的問題，得圖示如言詞辯論意旨狀第 43 頁：
- ⑧系爭專利說明書另指出：「因應製程中在反應室內所需要使用的圓形製程工件 14，例如矽晶圓，在較佳狀態下散流器的剖面亦為圓形，而不是如同在前述範例中的方形。在此情況下，進氣歧管的可彎曲懸置機構或側壁 24 可以為單一且無中斷的環形件」；「從另一方面來說，懸置機構的可彎曲性可以藉由分離成為軸向的數個延伸的部件而增加，而此分離係藉由軸向延伸的空隙，及如同先前說明之實施例裡方形側壁的四部件」（原證 4 號系爭專利說明書第 20 頁第 5-12 行）。
- ⑨圓形散流器中，為了增加「可彎曲性」，可以增加軸向的部件並藉空隙分離，得圖示如言詞辯論意旨狀第 44 頁。
- ⑩僅就系爭說明書第 16-17 頁（針對「方形」散流器「不希望完整而不中斷之設計」）之內容觀之，系爭專利已明確排除所有「單一完整，且有著方形切面的環形物」。
- ⑪再對照於系爭專利說明書第 20 頁關於「圓形」散流器之描述，其明確表示「圓形」散流器之「懸置機構或側壁 24 可以為單一且無中斷的環形件」，但為增加「可彎曲性」，亦得將其分割為四個部件。系爭專利說明書明示圓形散流器之懸置機構得有兩種選擇：1) 完整而不中斷，但可彎曲性較小；2) 分為四個部件，可彎曲性較大。此與其白紙黑字排除「方形」散流器懸置機構「完整而不中斷」之設計相互應證，更凸顯系爭專利本無意、亦不能涵蓋「方形」散流器懸置機構「完整而不中斷」之設計。
- ⑫第 1 項及第 16 項申請專利範圍之文字既可包含「圓形」及「方形」等散流器與懸置機構，而其說明書復明確不支持、且排除「方形」散流器懸置機構「完整而不中斷」之設計，第 1 項及第 16 項解釋後之範圍，自不包括「方形」散流器懸置機構「完整而不中斷」之設計。
- ⑬原告系爭專利之韓國對應案於申請程序中尚未經韓國專利局核准前，原告為爭取系爭專利對應案之加速審查，乃於 2004 年 3 月 15 日呈送一份「加速審查申請狀」，並檢附一份如下圖所示之實施該專利產品設計圖（該申請狀及該申請狀證據 2 之設計圖，詳參被證 27 號），原告自承該設計圖即為實施該專利案之設計，該設計圖清楚顯示方形散流盤懸置機構的四個角落，明確有截開之截角，屬於「不完整而中斷」（切割為「四片」）之設計，而非屬「完整而不中斷」之設計，完全與其前揭說明書之描述相符，益證被告之主張信而有徵

，併供本院參酌（言詞辯論意旨狀第 46 頁圖圓框所示者即為「四片」之切割處）。

14 實則，原告於 97 年 1 月 24 日庭呈之簡報文件第 9 圖，為原告實施系爭專利之氣體散流盤照片，照片中明確顯示該等產品於四個角落區具有「間隙」及「四片」之特徵，其產品特徵完全符合系爭專利說明書之描述（排除單一而連續之設計），而悖於系爭專利第 1 項及第 16 項未標明「四片」之要件。本院早已發現原告系爭專利具有此等問題，乃於 97 年 1 月庭訊時，要求原告說明原告目前商用化系爭專利之第五代以上之氣體散流盤，究竟有無未具有「間隙」及「四片」等特徵之商品，詎料，原告至今未予確實回復，其閃躲之心態，相當程度亦反映原告無從合理解釋此等不合常理之現象。

15 系爭專利韓國對應案之申請專利範圍的 26 項全部將懸置機構界定為「四片」或「多片」（韓國對應案之公告本，其第 1 頁顯示案號為「No. 00-000000」，與原告自認之案號相同，詳被證 28 號，其中以紅色螢光筆標示者為阿拉伯數字「4」片或韓文的「多」片；以黃色螢光筆標示者為韓文之「側壁」；於「雅虎」網站字典之功能選擇英文翻韓文，輸入「side wall」（側壁）之後，即出現「??」字樣，雅虎網站之字典頁面，詳被證 29 號）。縱原告之準備書 10 狀所「自認」之系爭專利韓國對應案，其第 1 項有「side walls are four」之字樣（準備書 10 狀第 17 頁第 1 行）；第 13 項亦有「a suspension comprising a plurality of side walls」之定義（準備書 10 狀第 17 頁第 5 行），其中「side walls」（複數）即為「側壁」之意；「plurality」即為「多數」之意，是以原告亦自認其韓國對應案之側壁有「四片」或「多片」之要件。實則，系爭專利之韓國對應案原提出申請時，其申請專利範圍原有 40 項，內容與系爭專利極為近似，其中僅有附屬項第 10 項（依附於獨立項第 1 項）具有「四片」之要件。惟韓國專利局否准其可專利性，並要求原告修正，原告乃將申請專利範圍修正為 76 項，韓國專利局仍認無從與證據三區別，而否認可專利性。後原告乃刪除其中 50 項，僅餘 26 項，此 26 項皆為獨立項，且每一項的懸置機構均定義為「四片」或「多片」之過程及由來。

16 按發明者，係將科技之研發成果訴諸文字，乃得據以向主管機關申請專利，其中申請專利範圍係申請人以文字表述該專利之權利客觀範圍，而說明書則供論證及支持該權利範圍確屬有據及可行之研發技術。故而專利法第 26 條第 3 項明定：

申請專利範圍「必須為發明說明書及圖示所支持」，違反本項規定者，依同法第 67 條第 1 項第 1 款規定，尚得作為舉發專利無效之事由。第 26 條第 3 項其立法理由略為：「按申請專利範圍係界定申請人欲請求保護之範圍，做為日後權利主張之依據，故申請專利範圍應如何記載，甚為重要。一般國家均僅就申請專利範圍之記載應能明確，其各請求項之記載應簡潔，且最重要者必須為發明說明所支持」。足徵未為說明書所支持之申請專利範圍，不僅屬無效專利，亦不得作為系爭專利之權利範圍。

- ①原告雖以系爭專利前揭說明書之記載，僅針對個別實施例之描述，並未有排除或限縮申請專利範圍之意。惟查，根據前揭說明書相關段落之完整記載，原告所「不希望」及所排除者，係「單一完整，且有著方形切面的環形物」，並非個別或單獨之實施例，遑論系爭專利通篇僅有一個實施例，亦即具有「間隙」及「四片」特徵之懸置機構，系爭專利既未提出任何可據以實施之其他實施例，則其所謂僅為排除單一實施例之辯詞，自無所據。
 - ②綜前，系爭專利除第 28 項之文字將懸置機構定義為「四片」之外，申請專利範圍第 1 項及第 16 項皆因欠缺「四片」之定義，鑑於系爭專利之說明書已明確排除「完整而不中斷的設計」，且系爭專利第 1 項及第 16 項申請專利範圍因欠缺記載「四片」之要件，而涵蓋其說明書所稱「不希望」之設計，明顯未為說明書所支持，則解釋後之系爭專利申請專利範圍第 1 項及第 16 項，自應包含「四片」之要件，否則超過此範圍者俱屬說明書所未支持事項。
 - ③查被告為韓國廠商，原告之所以未於韓國發動訴訟，要求被告停止「製造」行為；卻反於我國發動訴訟，要求被告停止在台根本不存在之所謂「販售」或「使用」行為，其捨近求遠、捨重就輕之原因，即在於系爭專利之韓國對應案因懸置機構均定義為「四片」或「多片」，根本無從作為論證被告侵權之基礎，原告明知於此，仍本於系爭專利向鈞院提起訴訟。惟其說明書仍留下線索，以白紙黑字排除「方形」散流器懸置機構「完整而不中斷」之設計，以限縮其第 1 項及第 16 項之解釋，望請鈞院明察為禱。
- (2)關於「可彎曲部分」的限制條件之二—「該可彎曲部分盡可能的長，以容納氣體散流盤的熱膨脹」、「材料具有延展性並不表示該材料的最終結構必然可彎曲」，且可彎曲部分之長度「受限於氣體散流盤厚度者」不在系爭專利之權利範圍

內：

- ① 被告前已於書狀及庭訊多次提及原告於專利舉發之階段為求維護專利之有效性，不僅三度提出申請專利範圍之更正，以求縮小系爭專利之範圍（蓋專利範圍越大，則遭舉發成功之機率越高；專利範圍越小，則專利權人越容易防禦），原告尚於舉發階段提出多份答辯書，主動限縮申請專利範圍之解釋，以寄望通過專利有效性之審查（蓋專利之解釋空間越大，則遭舉發成功之機率越高；解釋空間越小，則越容易防禦）。因此原告於專利舉發階段為防禦有效性的攻擊，而於答辯時所作之任何限縮權利或解釋申請專利範圍之表示，於其主張侵權時，自應受其拘束。
- ② 根據原告於舉發程序之陳述：「證據三之該可彎曲壁 146 的長度會小於氣體散流盤的厚度。然而，被舉發案申請專利範圍第 1 項所界定之至少一可彎曲部分係位於氣體散流盤之上，藉以使該可彎曲部分盡可能的長，以容納氣體散流盤的熱膨脹，而使可彎曲部分的長度不會受限於氣體散流盤的厚度」（原告 94 年 7 月 15 日專利舉發補充答辯書第 5 頁，詳被證 20 號；95 年 1 月 6 日專利舉發補充答辯書第 2 頁，詳被證 21 號；95 年 7 月 17 日專利舉發補充答辯書第 4 頁，詳被證 22 號）。
- ③ 另系爭專利說明書亦明確就懸置機構「可彎曲」之程度限定：「特別是在散流器與側壁間之此彎曲力量應該低至避免散流器的扭曲或裂痕，更細節來說，此一彎曲力應該低於 0.1mm=100micron 以防止扭曲散流器的外觀」（系爭專利說明書第 15 頁倒數第 7 行）。準此，系爭專利權利範圍所包含之「可彎曲」，有其結果及程度之限制。就結果而言，可彎曲「應該低至避免散流器的扭曲或裂痕」；就程度而言，可彎曲之彎曲力「應該低於 0.1mm=100micron 以防止扭曲散流器的外觀」。此等條件亦為解釋系爭專利第 1 項、第 16 項及第 28 項時，所不可或缺之必要限定。
- ④ 另查被告就系爭專利提出舉發時，曾質疑凡金屬必有可彎曲性，因此系爭專利申請專利範圍所稱之「可彎曲部分」，其意義及範圍並不明確，而不具可專利性。原告隨即於其舉發答辯回應：「材料具有延展性並不表示該材料的最終結構必然可彎曲」（95 年 7 月 17 日專利舉發補充答辯書第 5 頁，詳被證 22 號），因此原告為將系爭專利所稱「可彎曲」與一般金屬所普遍具有之延展性予以區別，乃就「可彎曲」之意義及適用範圍，作如上之限縮。

⑤綜上，申請專利範圍第 1 項所謂「可彎曲」不包括一般金屬之延展性，原告於論證被告構成侵害其系爭專利所定義「可彎曲」時，必須證明已達所謂「盡可能的長」，以致於足以產生「視其尺寸長厚比例及承受之外力」「彎曲程度足以緩衝該系統之熱膨脹應力」之結果，且懸置機構之長度「受限於氣體散流盤厚度者」，不在系爭專利之權利範圍內。合於前揭限制條件者，方始符合「專利侵害鑑定要點」所稱之全要件原則。

(3)系爭專利第 1 項、第 16 項及第 28 項均具有「連接」之要件，按依「連接」之基本文義，自係指兩以上不同物件之接合，故系爭申請專利範圍之解釋自應受此限制

①「連接」之文義係指兩個以上之不同物件以某種方式接合。「懸置機構」及「氣體散流盤」為一體成形時，會互相牽扯，「懸置機構」彎曲時，會扭曲「氣體散流盤」，達不到原告專利之功效，故原告專利之「懸置機構」及「氣體散流盤」須為兩個獨立構件相互連接，此為「連接」文義之所當然。

②此外，系爭專利說明書所揭示之技術內容中，「懸置機構」及「氣體散流盤」均為兩個獨立構件相互連接；如前所述，申請專利範圍必須為發明說明所支持，因此系爭專利第 1 項、第 16 項及第 28 項之「連接」要件，必須解讀為兩個獨立構件相互連接。此業為 99 年 10 月 15 日審判筆錄本院及技術審查官之意見所確認在案。

③縱原告亦自承：

(甲)「除氣體散流盤及懸置機構本身外，系爭專利之請求項（claim）中亦包含對兩者間之結構關係之敘述。換言之，氣體散流盤及懸置機構間之結構關係亦屬判斷本件被告之系爭設備是否侵權之重點」（原告 96 年 8 月 3 日陳報狀第 3 頁第 4 行）；

(乙)「蓋就技術層面而言，氣體散流盤與懸置機構實具有結構上及功能上之密切關聯性。懸置機構之作動原理及特性，均受氣體散流盤之特性及兩者間之連結關係所影響」（原告 96 年 8 月 3 日陳報狀第 3 頁第 7 行）；

(丙)「此外，懸置機構上之部分特徵及參數係與氣體散流盤具有相對性，因此單就懸置機構本身並無法判斷部分之特徵，而需綜合兩者之關係加以分析。例如氣體散流盤與懸置機構之連接方式，以及氣體散流盤本身之熱膨脹係數，均會對懸置機構之可彎曲性產生影響」（原告 96 年 8 月 3 日陳報狀第 3

頁第 10 行)；四、根據 CNS 製圖標準：「同一物體由同一切剖面所形成之剖面，其剖面線方向及間隔均應一致」(被證 54 號)系爭機密圖示(言詞辯論意旨狀第 53 頁上圖)明確顯示：懸置機構與散流盤為同一物體。

根據 CNS 製圖標準：「由數件組合之剖面圖，相鄰兩物體所畫之剖面線，其角度相同但方向相反」(被證 54 號)根據系爭專利第 4 圖(言詞辯論意旨狀第 53 頁下圖)，其懸置機構與背壁及散流盤之剖面線，恰為角度相同但方向相反。懸置機構與背壁及氣體散流盤之間顯為不同之獨立構件。

④根據原告前揭自認之事實，系爭專利所稱氣體散流盤與懸置機構兩者間之「連接」關係，本屬判斷侵權之重要因素，本院 98 年 12 月 30 日所詢之五個技術問題中亦包含：「系爭專利申請專利範圍所稱的『連接』關係」應如何界定之問題，原告迄今僅稱該「連接」係指「名詞」，而非「動詞」云云，均未正面回應此一鈞院之提問。不過基於原告前揭自認之陳述，當已可證「連接」為解釋系爭專利申請專利範圍所不可迴避之重要問題，除非兩個獨立構件以「連接」方式組成，否則即與系爭專利之權利範圍無關。

4. 不侵權抗辯：被告並未侵害原告之專利權，理由如下：

此部分被告之陳述，請見密封附件之說明。

5. 損害賠償計算

(1)原告於新台幣 500 萬元之額度內(即起訴之金額)，或得主張以專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定為基礎計算損害賠償，惟超過此數因囿於訴之擴張罹於 2 年時效之故，原告乃追加不當得利為其請求權基礎，惟原告迄今未證明本件事實合於不當得利之三項法律要件，即魚目混珠逕以專利法第 85 條規定一併為主張，原告此舉顯與不當得利之法律要件有所未合。

(2)專利權之私權效力範圍以申請專利範圍所界定之技術內容為據，超出申請專利範圍外之領域乃屬公知，非專利權人所得請求排除侵害或損害賠償之對象。原告主張侵權之系爭專利第 1 項、第 16 項及第 28 項既均僅涉散流盤之「懸置機構」，其以所謂整部 PECVD 設備之售價 900 萬美金作為損賠計算之基礎，自乏根據：

①專利法第 56 條第 2 項規定：「發明專利權範圍，以說明書所載申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時並得審酌發明說明及圖式」，故凡非屬申請專利範圍所界定、描述之技術，自始即與專利權之效力無關，不得作為請求排除侵害或損

害賠償之基礎。

- ②原告據以主張權利之系爭專利第 1 項、第 16 項及第 28 項，渠等申請專利範圍均僅涉「散流盤」（整部 PECVD 設備中，千百項零件之一）之「懸置機構」（零件中的零件），然原告於主張損害賠償數額時，竟以整部 PECVD 設備之售價美金 900 萬元為據，原告之主張顯悖於專利法第 56 條第 2 項之規定及前揭判決之意旨，原告之主張自無可採。
- ③原告主張發明專利侵害，並請求損害賠償，其基礎應以與專利權有關之部分為度，此為我國智財案件審判實務。蓋原告之請求，原不得涵蓋與其專利技術貢獻無關之部份，此理至明。智慧財產法院 97 年民專上易字第 4 號判決即指出：「系爭專利之申請專利範圍僅及於燈座及燈體，並不及於燈泡，此有新式樣專利圖說中第一至七圖在卷可按（見本院卷第 144 頁反面至 145 頁），是以被上訴人販賣涉案嵌燈之價格自應扣除燈泡部分」（全文詳參被證 50 號），可證專利權人行使權利之範圍無論如何均不得逸脫與申請專利技術實質有關之部分。
- ④原告稱：系爭 PECVD 設備若移除懸置機構，勢將無法操作，故損害賠償之計算應以整部設備之價值為據。惟查，任何零件與設備之間本係立於缺一不可之關係，例如設備中的一棵螺絲釘，若螺絲釘未固定好則整部機器均無法運作，至今已有多起國際空難事件之調查指出事故發生之原因在於使用規格不符之螺絲釘，新近華航波音客機在日本發生爆炸，調查後亦指出係因螺絲釘突出，導致戳破機翼油箱所致，然此俱屬使用上及功能上之不可或缺性，不代表有所謂價值上之不可或缺性，此節不可不辨，否則依原告之邏輯，一棵螺絲釘之價值將等於整部飛機，顯見並非合理，原告之主張顯不可採。
- ⑤原告自己亦承認：「本件訴訟涉及周星公司之第五代電漿輔助化學氣相沈積設備中之『氣體散流盤組件』（即包括氣體散流盤及其懸置機構）」（原告 96 年 6 月 25 日陳報狀第 2 頁第 7 行）。原告甚至承認：「原告主張依業界慣例，購買電漿輔助化學氣相沈積設備者都同時會購買該設備中之各項零組件備品」（原告 96 年 6 月 25 日陳報狀第 2 頁第 15 行）。原告既已明知本件訴訟非關整部系爭設備，而僅係有關係爭設備之散流盤之懸置機構（事實上尚不包括散流盤本身），則原告逕自以整部設備之價值為據主張損害之計算，並將價值比例扣抵之舉證逕自轉由被告負擔，原告此舉顯悖於舉證責

任分配之法則。原告既主張包含懸置機構之氣體散流盤為必購買之備品零件，則原告應自知零件之價格絕不等於整部設備之價格（原告自己亦為從事相同生意之廠商），則原告自應先證明零件之價格，方有主張損賠數額計算之適格。

三、程序部分：

1. 按訴狀送達後，原告不得將原訴變更追加他訴，但有下列各款情形之一者不在此限：……二請求之基礎事實同一者。三擴張或減縮應受判決事項之聲明者。……。民事訴訟法第 255 條第 1 項第 2 款、第 3 款定有明文。
2. 本件原告起訴時，訴之聲明原為：「一被告不得利用原告所有經濟部智慧財產局核准專利第 152996 號專利為自己或他人製造「型號 EUREKA 6000」之「供液晶顯示器用之電漿輔助化學氣相沈積設備(PECAV for LCD)」，及其他具有相同或相等設備或方法之產品(以下簡稱系爭產品)。二被告不自己或其雇用人或其履行輔助人，為買受人提銷售後之安裝、設定、測試、技術指導、操作訓練或維修等服務，或其於其他原因，而使用系爭產品。三被告不得由自己或其雇用人或其履行車助人，就系爭產品為販賣、輸出、輸入或為其他交付予買受人之行爲。四被告不得以產品發表會、說明會、觀摩會、居示會、刊登廣告、產品目錄、拜訪客戶或其他方式為系爭產品之買賣促銷行爲。五被告應連帶給付原告台幣伍百萬元整及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。六訴訟費用由被告負擔。」其後訴之聲請變更為「一被告不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口「型號 EUREKA 6000」之「供液晶顯示器用之電漿輔助化學氣相沈積設備」及其他侵害原告所有中華民國發明第 152996 號專利之電漿輔助化學氣相沈積設備。二被告應連帶給付原告新台幣壹億柒仟捌佰貳拾萬圓，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。三訴訟費用由被告負擔。四原告願供擔保請准宣告假執行。」係在基礎事實同一之範圍內，擴張請求被告給付賠償之金額，減縮要求被告不得侵害專利權之具體作為，依前開民事訴訟法之規定，應予准許。
3. 原告主張被告侵害原告美商應材公司系爭專利權申請專利範圍第 1 項、第 16 頁、第 18 項，其後原告撤回申請專利範圍第 16 項及第 18 項之主張，被告則表示不同意原告撤回該主張，按「原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。」民事訴訟法第 262 條

第 1 項定有明文，本件原告主張被告侵害原告美商應材公司前開系爭專利權之申請範圍，由第 1 項、第 16 項、第 18 項減縮為第 1 項，係在同一訴訟標的範圍內所為之減縮，與撤回訴訟全部或一部不同，自無須被告同意，該部分撤回之主張，應認合法，合先敘明。

四、本件兩造爭執事項如下：

- (一)、被告所製造販賣「型號 EUREKA 6000」之「供液晶顯示器用之電漿輔助化學氣相沈積設備(PECAV for LCD)」，是否落入系爭專利申請專利範圍第 1 項？
- (二)、被告英屬蓋曼群島商周星科技公司第一次舉發案所提出之證據及第二次舉發案所提證據組合是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性？
- (三)、如被告有侵害系爭專利權，應負侵害系爭專利之損害賠償責任時，原告前開訴之聲明之請求是否有理由，即原告得請求損害賠償之數額為何？

五、本院得心證之理由：

(一)、系爭被告所製造販賣「型號 EUREKA 6000」之「供液晶顯示器用之電漿輔助化學氣相沈積設備(PECAV for LCD)」，並未落入系爭專利申請專利範圍第 1 項之範圍：

1. 按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，專利法第 56 條第 3 項定有明文。判斷被控侵權對象是否侵害專利權，首先應依專利說明書所載之申請專利範圍為準，倘申請專利範圍之文字已臻明確時，應以其所載文字在該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請專利時所認知或瞭解支持該文字之通常習慣總括之意義予以解釋，自不得以申請專利範圍所未記載卻揭示於發明說明及圖式之限制條件讀入申請專利範圍；反之，倘申請專利範圍之文字有不明瞭或疑義時，自得審酌發明說明及圖式用以輔助解釋申請專利範圍中既有之限制條件，亦即依據說明書整體內容及該文字之用法，確定申請專利範圍所載之發明內涵，適切地界定專利權範圍。

2. 系爭專利權申請專利範圍之說明：

- (1) 系爭專利更正後申請專利範圍共計 40 項，其中第 1 項、第 16 項以及第 28 項為界定物之獨立項，第 36 項及第 40 項為界定方法之獨立項，其餘為附屬項。因本件原告僅主張被告所造販賣之系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第 1 項，如前揭說明，以下就申請專利範圍第 1 項加以說明。
- (2) 系爭專利權申請專利範圍第 1 項係「一種用於電漿室的進氣

歧管，該歧管至少包含：一背壁，且該背壁有一進氣穿孔(orifice)；一氣體散流盤(gas distribution plate)，且該氣體散流盤有數個出氣穿孔，而該氣體散流盤與該背壁有分隔且位於該背壁下方；及一懸置機構(suspension)有一第一端、一第二端、及該第一端與該第二端之間且位於該氣體散流盤之上的至少一可彎曲部分；該第一端連接於該背壁；該第二端連接於該氣體散流盤；以及該懸置機構圍繞著該進氣歧管中的區域，該區域延伸至該背壁與該氣體散流盤之間，且其中之該進氣穿孔與該出氣穿孔為該區域的流體傳遞(fluid communication)。」圖式如附件圖一所示。

(3)系爭專利權申專利範圍第 1 項「懸置機構」應為獨立構件：

- ①原告主張系爭專利之「懸置機構」，不論是獨立構件或「一體成型」均為系爭專利申請範圍所涵蓋，並舉第一次舉發案之前開台北高等行政法院 97 年度訴字第 739 號判決、最高行政法院 99 年度判字第 945 號判決為憑。
- ②惟台北高等行政法院及最高行政法院前開判決，並未明白確認原告所主張的系爭專利之「懸置機構」，不論是獨立構件或「一體成型」均為系爭專利申請範圍所涵蓋，況惟系爭專利申請專利範圍第 1 項為裝置之請求項，以依序排列之元件的結構順序予以撰寫，並界定懸置機構有「一第一端、一第二端及該第一端與第二端之間且位於該氣體散流盤之上的至少一可彎曲部分」以描述首尾兩端之間整個懸置機構。另系爭專利說明書中第 3 頁對先前技術的缺點描述為「傳統的氣體散流盤一般直接固定於電漿室的側壁(side wall)或蓋子(lid)，此部分具有高熱量及高傳導性所以此蓋子及側壁亦可為散熱器的功能，以將熱抽離氣體散流盤，故傳統的設計會將氣體散流盤保持在低溫，正是一般所不樂見。」因此側壁與氣體散流盤的直接固定緊密連接屬習知技術。再者，系爭專利說明書中並無一體成型的態樣，故「懸置機構」以一體成型相連接的方式，尚難為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋。經參酌系爭專利說明書及圖示，系爭專利技術手段，在於提供懸置機構與背壁以及懸置機構與氣體散流盤之間的連接型態，例如系爭專利說明書第 17 頁、22 頁及 2、4、5、9、10、12、13 圖各實施例，均顯示懸置機構為獨立構件時之連接型態。系爭專利說明書第 17 頁提及懸置機構(側壁)需與氣體散流盤焊有接點 56 以確保緊密接觸。因此系爭專利申請專利範圍第 1 項之懸置機構在文義的解釋上應屬一獨立構件，原告前開主張尚無可採。

3. 被告所製造販賣之系爭產品是否侵害系爭專利之判斷：
經分析結果認被告製造販賣系爭產品並未落入系爭專利 1 申請專利範圍第 1 項之文義或均等範圍，而不構成侵害。此部分分析理由，請見密封附件說明。
- (二)、本件既認系爭產品未侵害系爭專利權，則就該系爭專利是否有被告所主張之得撤銷之事由、被告如侵害專利權應賠償之數額為何等事項，即無再論述之必要，附此敘明。
- 六、綜上所述，被告製造販賣系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍第 1 項之文義或均等範圍，而不構成侵害，原告主張被告製造販賣系爭產品，侵害其專利權，請求被告不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口「型號 EUREKA 6000」之「供液晶顯示器用之電漿輔助化學氣相沈積設備」及其他侵害原告所有中華民國發明第 152996 號專利之電漿輔助化學氣相沈積設備及被告應連帶給付原告 178,200,000 元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之 5 計算之利息，即無無理由，應予駁回，其假執行之聲請，亦失所附麗，應併駁回之。
- 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法暨未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
- 八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第 78 條，判決如主文。
- 參、反訴部分：
- 一、反訴原告之聲明及陳述：
- (一)、聲明：
1. 反訴被告等應連帶負擔費用，將反訴判決書之摘要內容全部以「十全（即長 25 公分寬 30 點 5 公分之版面）」之規格刊載於中國時報、自由時報及聯合報第一版乙日。
 2. 反訴被告等應連帶給付反訴原告新台幣壹千萬元整及自反訴起訴狀送達之日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。
 3. 前兩項請求，反訴原告願供擔保，請准宣告假執行。
 4. 訴訟費用由反訴被告等二人連帶負擔。
- (二)、陳述：
1. 反訴原告提起本件反訴之基礎事實有二：(1) 反訴被告明知專利無效而仍聲請假處分及提起本案訴訟（詳參反訴起訴狀第 5-8 頁）；(2) 反訴被告明知所謂「周星 ABC」為內容不實資料，而仍據以提起本件訴訟（詳參反訴起訴狀第 8-10 頁）。
 2. 反訴被告之公司背景、兩造所處之市場特殊情狀及反訴被告

急於藉由專利侵權訴訟打壓反訴原告之商業考量：

- (1)反訴被告係全球最大半導體製程設備與服務供應商，全球員工超過 1 萬 3000 名，其於 92 年間聲請假處分時其所生產之半導體製程產品（包括系爭設備）年度訂單高達 123 億美元，營業淨利為 21 億美元，折合約新台幣約 693 億元。系爭設備主要經反訴被告應用材料公司出資研發後，再利用其子公司反訴被告業凱公司進行製造及銷售。以假處分提出之時點 92 年而論，反訴被告業凱公司就系爭設備銷售量及銷售額全球市場占有率分別高達百分之 78 以及百分之 81，就系爭設備擁有全球市場獨占地位，其在我國市場亦享有約 8 成市占率，與我國經濟部市場調查資料吻合（反原證 1 號 參照）。
- (2)根據 93 年 1 月 29 日工商時報報導，反訴被告就系爭設備於相關市場之市占率為 78%，工商時報並製作下表為憑，足證反訴被告之獨占市場地位（報導全文詳反訴原告證 15 號）。

國內 TFT 化學氣相沈積(CVD)設備廠商裝機概況表（單位:台）

| 廠商名稱 | 美商 AKT | 瑞士商 Unaxis | 韓商 JuSung |
|------|--------|---------------|---------------|
| 友達光電 | 50 | 0 | 0 |
| 奇美電子 | 14 | 6(另有 2 台下月裝機) | 1(另有 2 台下月裝機) |
| 中華映管 | 0 | 19(另有 7 台待交機) | 0 |
| 瀚宇彩晶 | 23 | 1 | 0 |
| 廣輝電子 | 12 | 0 | 0 |
| 統寶光電 | 14 | 0 | 0 |
| 合計 | 113 | 26+9 | 1+2 |

- (3)92 年 10 月間反訴原告首度將系爭設備第 1 部交付我國奇美公司，實屬破冰之交易。且我國其餘廠商亦陸續接洽反訴原告以期以較低廉價格獲取系爭設備及更高品質服務，然此舉直接威脅反訴被告等長期高市占率及獨占地位。反訴被告等雖明知其據爭專利具無效原因或至少需經修正後方能維護有效性，卻迫不及待地以粗糙證據資料提出訴訟之真正原因在於，92 年下半年及 93 年上半年為我國液晶面板廠商資本支出更新採購製程設備之黃金時間，故縱然反訴被告等明知其據爭專利無效且證據資料甚為薄弱，但以耳語及信函寄發接觸我國相關廠商藉以提出侵權警告後，聲請假處分及本案訴訟之效果絕對有助其繼續鞏固可能迅速下滑之市場佔有率，以及時向我國液晶顯示器製造商傳達並造成使用原告系爭產品者同冒專利侵權風險之懸疑效果。因系爭設備動輒新台幣數億元，我國廠商經應材公司之警告及濫訴後，皆紛紛要求原告

提出解釋，並且紛紛結束與原告之商務接洽。反訴原告經反訴被告此等之專利濫用之訴訟策略，在我國已失去相關廠商之信任，而婉拒採購反訴原告之系爭設備，損失至鉅，反訴原告迄至今日，從未再於我國地區銷售出任何系爭設備。

(4)此觀之相關媒體報導：「液晶面板產業是一個寡占的市場，先進者爲了阻止後進者進入，常會祭出專利權訴訟，阻止後進者以低價搶占市場，並維持其寡占地位。…周星五代廠設備，近來積極以較低之價格擴展市場，不僅獲得奇美電的青睞，也被全球第一大面板廠樂金飛利浦所採用，AKT（按：即反訴被告美商業凱科技股份有限公司）眼看競爭對手開始茁壯，當然要以專利侵權的使段，阻止對方繼續壯大」（93年2月16日經濟日報，詳反原證16號）；「最近南韓CVD廠商JUSUNG積極來台佈線，引起AKT與應材的重視，並在日前對JUSUNG提出相關的侵權訴訟，並對已經在奇美裝機試產的一台JUSUNG設備，以及其他幾台已經運到、尚未裝機的設備申請假扣押。對此奇美董事長許文龍表示，設備廠商之間的激烈競爭相當可以理解，不過此次的事件AKT已更在事前與奇美取得協議，將以盡量不影響奇美的量產規劃爲前提」（工商時報，詳反原證15號）。

(5)僅就此事件必須驚動當時奇美的董事長許文龍先生親自出面發言滅火，即可知反訴被告利用不當之訴訟手段遂其商業目的之成功。反訴被告亦藉此成功塑造向反訴原告購買系爭設備之液晶面板廠商，其投產之時程規劃可能會受到影響，除非事前與反訴被告取得協議。單就液晶面板廠商向反訴原告購買系爭設備必須事先取得反訴被告之諒解觀之，反訴被告已徹底向市場傳達一項重要訊息：向反訴原告購買系爭設備者，必將招致不必要之麻煩，此恰爲反訴被告提出假處分及專利侵權訴訟之目的，至於提起本件本訴6年後之今日，訴訟之輸贏對於反訴被告而言已非首務，蓋其藉由訴訟行動封鎖反訴原告商業活力之目的，早已成功達成，此即爲本件反訴之核心事實背景。

2. 根據經濟部官方之統計資料顯示，反訴被告於系爭市場之占有率超過八成，其當屬獨占事業無疑

(1)所謂獨占企業，依我國公平交易法第5條之規定，指事業在特定市場處於無競爭狀態，或具有壓倒性地位，可排除競爭之能力者而言。同法第5條之1將一事業在特定市場之占有率未達二分之一者，不列入獨占事業之認定範圍。依該條文文義之反面解釋，在我國於特定市場之占有率達二分之一以

上者，即可被認定為法律上之獨占事業。

(2)另據行政院公平交易委員會自行頒訂之「常問問題 FAQ-獨占事業認定等相關規範」第 28 題明揭：「公平交易法所稱獨占，應審酌之事項包括：事業在特定市場之占有率達二分之一（按：即 50%）。事業在特定市場之占有率達三分之二（按：即 67%）。事業在特定市場之占有率達四分之三（按：即 75%）」（反原證 17 號參照）。

(3)根據我國經濟部之調查，反訴被告於系爭設備之市場占有率高達八成（80%，詳反原證 1 號），則依行政院公平交易委員會自行之定義，其於系爭市場屬於獨占事業無疑。

3. 針對請求權基礎為公平交易法第 30 條及第 34 條部分

(1)首就公平交易法第 47 條有關未經認許之外國法人提起本件反訴之程序問題，查反訴原告英屬蓋曼群島商周星科技股份有限公司為依我國公司法設立之法人，並無此程序問題。

(2)另就反訴原告韓商周星工程公司部分，根據韓國律師 Ms. Ji Hyun Kim 所出具之法律意見（詳反原證 18 號），韓國法令或實務並無排斥或禁止我國法人於韓國本於韓國之不正競爭法提起訴訟之規定或案例，應可推知我國法人於韓國亦享有相對等之程序權利，遑論韓國及我國俱為 WTO 之會員會，同受 TRIPs 之拘束，斷無排除反訴原告韓商周星工程公司提起本件反訴之理。

4. 針對請求權基礎為民法第 184 條第 1 項前段部分

(1)依最高法院歷來見解，提供虛偽陳述或不實資料，以利用司法機關之訴訟調查作為損害他人之手段者，亦該當侵權行為而應負損害賠償責任

①按最高法院 83 年台上字第 2261 號民事判決明揭：「行為人故為虛偽之陳述，使司法機關為犯罪之訴追，致他人受有損害者，倘係利用司法機關有追訴犯罪之職權，以侵害他人權利，自屬侵權行為，不因司法機關依法追訴犯罪而阻卻違法」（反原證 12 號）。

②再按：「按票據上權利之行使，與票據之占有，有不可分離之關係，非票據之執票人不得行使之。上訴人明知非系爭支票之執票人，不得行使支票權利，竟以其影本，利用督促程序，取得支付命令，而對被上訴人強制執行，乃故意不法侵害被上訴人權利，應負侵權行為損害賠償責任」、「上訴人請求被上訴人給付系爭票款固經發給支付命令確定在案，惟其以不法行為取得該執行名義，侵害被上訴人權利，應准被上訴人以侵權行為法律關係尋求救濟，以臻衡平」，最高法

院 84 年台上字第 196 號民事判決稽之甚詳(反原證 13 號) 。

④根據前揭最高法院判決意旨，反訴被告未善盡蒐證及舉證之責，以內容不實，出處及來源復不明之「周星 ABC」，據以濫行聲請假處分及提起專利侵權訴訟，其濫用司法制度之故意侵權行為，不因為有透過司法途徑而得以阻卻違法或免除其損害賠償責任。

(2)反訴被告所提供據以作為聲請假處分及起訴之事實資料-「周星 ABC」，出處及來源迄今不明，內容多有矛盾可疑，依前揭最高法院判決意旨，反訴被告亦顯該當侵權行為

①據反訴被告稱：「周星 ABC」分別來自於員工甲、乙及客戶 A、B（95 年 10 月 25 日反訴被告於本訴所提準備書一狀第 7-8 頁），至於該等文件之真正來源，迄今不明。

②另原告起訴狀原證 4 號第 68 頁圖式所示結構，以及第 69 頁圖式所示結構（兩圖示皆由「周星 ABC」中所擷取而出），兩者明顯不同，此縱一般人以普通知識程度，稍加觀察比對即可得知，故兩圖示顯為不同之機器設備，此部分已由反訴原告委請台大慶齡工業研究中心所製作之鑑定報告詳予指摘（台大慶齡工業研究中心鑑定報告第 17 頁，詳反原證 14 號）。

③根據該鑑定報告之專業意見，原證 4 號第 68 頁、第 69 頁兩圖式所示結構，可能包含三種不同之機器設備，則反訴原告以此等出處來源不明、彼此復有差異之不同圖示，據以指控所謂反訴原告之單一機器設備侵害其專利權，反訴被告前揭所為顯低於一般之注意程度，足徵其該當侵權行為之故意過失。

④反訴被告持不明來源圖示據以提出假處分及本件訴訟，其訴訟行為之瑕疵自不得以反訴原告於訴訟中否認該「周星 ABC」文書之真正，而豁免其侵權行為之責。

5. 損害賠償

(1)在本訴，反訴被告不僅於起訴後三度更正其申請專利範圍；尙四度變更其據以起訴主張專利侵權之法律基礎：1) 起訴時：文義侵害第 1、16、28、36 及 40 等項；2) 後變更爲：文義侵害第 1、16 及 28 等項；3) 再變更爲：文義侵害第 1 項；4) 最後變更爲：均等論侵害第 1 項。凡此均足證反訴被告於提起本訴時之意圖及動機本不在於合法訴權之行使，而在於不當濫用其專利以打擊反訴原告之商業市場。

(2)自從反訴被告聲請假處分及提起本訴後，反訴原告就系爭產品再未成功銷售任何一台，反訴被告事實上已成功藉由其濫用專利之行為封鎖反訴原告原本已就系爭產品開發出之市場

。實則，由於 PECVD 設備之購買者極度集中，台灣原本之面板五虎經由整併後目前已僅剩兩大廠商（友達及奇美），第三家廠商華映即將遭併購之傳聞迄今不斷，因此所有的潛在買家對於反訴被告所聲請之假處分及提起之本訴，均知之甚稔，縱反訴原告於拜訪客戶推銷非系爭產品之 PECVD 設備時，所有的潛在買家均會主動關心、詢問反訴被告所提本訴之進度，以確認渠等向反訴原告購買其他機型時是否將面臨侵權之干擾，以致於反訴原告於推廣業務時面臨極大之困難。惟囿於業界習慣，買家均不願涉入設備供應商之間之糾紛，以致於反訴原告無從尋得適當證人以就此等不證自明之事實補提證詞。

(3)有鑑於此，請審酌民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，審酌反訴原告之主張，判決如訴之聲明所述。

二、反訴被告之聲明及陳述：

(一)、聲明

- 1.反訴原告之訴暨假執行之聲請均駁回。
- 2.反訴訴訟費用由反訴原告負擔。
- 3.如受不利判決，反訴被告願供擔保請准宣告免為假執行。

(二)、陳述：

- 1.最高行政法院業已確認反訴被告並未違反公平交易法之規定，反訴原告之請求並無依據本件反訴原告於民國(下同)93年1月就相同主張向我國公平交易委員會(以下簡稱「公平會」)提出檢舉，惟無論是公平會處分書(反被證1)、行政院訴願委員會訴願決定書(反被證2)、台北高等行政法院判決(反被證3)及最高行政法院判決(反被證7)皆認定反訴被告等並無違反公平交易法之規定。最高行政法院判決理由明確為如下之認定(反被證7)：

①反訴被告並非公平交易法之獨占事業；

②專利法並未課予專利申請權人絕對之揭露義務，專利申請權人可在法律許可範圍內，依其風險、利益而為取捨，故縱使其於事後減縮專利範圍，亦係依法行使權利，難謂其取得專利時已「明知系爭專利具有重大瑕疵」。且我國專利之專責機關智慧財產局於審查專利申請案時，亦以公正立場判斷有無先前技術之存在，須經該局審查符合專利法保護要件，才會公告授予專利權。為專利舉發案之主管機關智慧財產局，嗣亦未因反訴原告所提起之舉發案而為系爭專利無效或撤銷之認定。反訴被告對於反訴原告所提起之假處分訴訟係基於專利權之正當行使，並未濫用專利權；

④反訴被告聲請假處分所提供之「圖示、取得資料之過程、細節及證據」，以及前揭圖示內容為同一產品之說明等，皆已提出於假處分之管轄法院即桃園地方法院，經該院斟酌兩造之法律見解，仍為「准為假處分」之裁定，並經抗告駁回，可知管轄法院並未認定系爭專利之行使有何不法。反訴原告既認桃園地院所為准予假處分之裁定違法不當，已循抗告程序加以主張，自不能要求公平會就假處分裁定之內容是否有當予以實質審查，公平會因而未認定系爭專利有濫用情形，自無違誤；

④反訴被告寄發予奇美公司之信函並非法律定義之警告函且反訴被告與奇美公司之聯繫並未違反公平交易法。前揭最高行政法院之判決理由已足以充分說明本件反訴原告之反訴於法無據。反訴被告謹就反訴原告之主張，詳細駁斥如下：

2. 反訴被告美商業凱科技或反訴被告美商應用材料並非獨占事業，不適用公平交易法第 10 條有關獨占事業之規定反訴被告美商業凱科技為反訴被告美商應用材料之子公司，兩公司為各自獨立之法律實體。系爭氣相沉積設備產品係由反訴被告美商業凱科技所製造及販售，反訴被告美商應用材料並未製造及販售系爭產品。無論是反訴被告美商業凱科技或反訴被告美商應用材料，就系爭產品於我國市場皆非公平交易法所定義之獨占事業，謹說明如下。

(1) 依照公平交易法施行細則之規定，事業是否為獨占事業應就市場占有率、商品替代可能性、影響市場價格能力及他事業加入市場難易等因素綜合判斷依公平交易法施行細則第 3 條規定，除市場占有率外，獨占事業之判斷應審酌之因素，尚包括(1) 商品或服務在特定市場變化中之替代可能性；(2) 事業影響特定市場價格之能力；及(3) 他事業加入特定市場有無不易克服之困難情形等等，故市場占有率僅為諸多判斷因素之一。因此，公平交易法第 5 條之 1 第 1 項雖規定：「事業無左列各款情形者，不列入前條獨占事業認定範圍：一、事業在特定市場之占有率達二分之一。」惟本條規定目的係排除市場占有率未達 2 分之 1 之事業，無須作為獨占事業加以考量，惟不得據以反面推論在我國特定市場之占有率達 2 分之 1 以上之事業，即可被認定為法律上之獨占事業。亦即，公平交易法第 5 條之 1 係說明獨占事業必須達到市場占有率之最低標準，縱使一事業之市場占有率達到該最低標準，並非必然即為獨占事業，仍需全盤考量公平交易法施行細

則第 3 條規定之所有因素以判斷是否為獨占事業。

(2)反訴被告美商應材並非系爭產品之製造或銷售事業，不可能為系爭產品之獨占事業反訴被告美商應材為半導體製程設備之製造商，並未生產、銷售系爭產品即「液晶顯示器使用之電漿輔助化學氣相沈積設備；PEVCD for LCD」。系爭產品係運用於面板之製造而非用於半導體之製造，兩者不具可替代性，是反訴被告美商應材尚非系爭產品市場之參與者，更遑論具有獨占地位。

反訴被告美商業凱及被告美商應材為各自獨立之法律實體，各自製造、販售不同之產品。反訴原告主張被告美商應材意圖掩護子公司反訴被告美商業凱在系爭設備之市場保持獨占地位，濫行訴訟排除他事業競爭云云，皆係毫無根據之不實指控。

(3)反訴被告美商業凱科技並非公平交易法下之獨占事業如前述，僅憑事業於特定市場之占有率不足以認定是否具有獨占地位；綜合前述公平交易法施行細則第 3 條規定之各項因素為考量，反訴被告業凱科技就系爭產品並不具獨占地位，應無疑問：

①反訴被告美商業凱之市場占有率每年變動甚大，不應以單一年度之市場占有率論斷反訴被告美商業凱之市場力量

(甲)系爭產品市場競爭激烈，市場占有率變動起伏甚大，且系爭產品之特色為訂單總量少但單價高，損失任何一訂單即會對於系爭產品所占銷售比率造成極大之影響，例如西元 2000 年及 2001 年 間，反訴被告美商業凱於全世界之市場占有率自 1999 年之 84% 下滑至 47%(詳反被證 4 號)，而該落差為損失單一訂單所致。此事實顯示系爭產品市場之競爭激烈，市場占有率隨時可能大幅變動，不足以判斷該事業是否具有獨占市場之力量。況倘以其 2001 年 市場占有率僅有 47% 為論，反訴被告美商業凱尚未跨越作為獨占事業討論之最低門檻。

(乙)反訴原告於反訴起訴狀第 4 頁所援引之反原證 1 號即經濟部「2005 平面顯示器年鑑」關於反訴被告美商業凱市場占有率之內容係關於全球市場之占有率，不得據以主張反訴被告美商業凱系爭產品於台灣市場之占有率為 80%，且該年鑑僅針對特定年度為描述，無法具體反應出系爭產品市場變動率極大之特性或反訴被告業凱科技之市場力量。

②系爭商品在特定市場中有高度替代可能性於 92 年及 93 年間系爭產品於我國之銷售市場中，買方僅有友達光電、奇美電子、中華映管股份有限公司、瀚宇彩晶股份有限公司、群創光

電股份有限公司、廣輝電子股份有限公司、統寶光電股份有限公司等面板廠商。反觀販售系爭產品之競爭者除反訴原告韓商周星工程公司外，尚有韓商 Atto、日商 Anelva、ULVAC、Kokusai 及列支敦斯登之百瑟(Unaxis) (反訴被告證 5 號) 等，反訴被告美商業凱科技並非反訴原告之唯一競爭廠商，上述事業產製之系爭產品皆具相互替代性及直接競爭性。

④反訴被告美商業凱並無影響系爭產品市場價格之能力系爭產品競爭激烈，價格依供應廠商競爭策略而定，差異甚大，有以較低價格以取得市場優勢者，或以較優良性能以高價販售其產品者，各供應廠商之價格皆與反訴被告美商業凱差異極大，非反訴被告美商業凱所能控制。

④他事業加入系爭產品市場並無不易克服之困難我國廠商對系爭氣相沈積設備產品之需求皆仰賴進口，而我國法令對系爭產品之進口並無限制。實際上目前我國系爭產品之市場亦已有眾多競爭者，足證他事業加入系爭產品之特定市場並無困難。

3. 反訴被告對反訴原告提起假處分及本件訴訟係依有效之專利權正當行使權利，並未濫用專利權：

(1) 系爭專利係依我國專利法正當程序取得並經智慧財產局審定公告之合法專利，且反訴被告系爭專利之有效性業已經智慧財產局、台北高等行政法院及最高行政法院確認，反訴原告指摘反訴被告明知系爭專利無效云云，委無可採：

①依我國專利法第 51 條第 2 項規定，申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，是經濟部智慧財產局(下稱「智慧局」) 審定公告之專利即為有效之專利。系爭專利經智慧局審查後核准專利，其有效期間為 2002 年 3 月 12 日至 2021 年 1 月 15 日(反訴被告證 6 號)。美商應材係於 2003 年 12 月 25 日取得桃園地方法院假處分並於 2004 年 6 月提起本件訴訟，顯示反訴被告美商應材對反訴原告提起假處分及本件訴訟時，系爭專利依法本屬有效。

②反訴原告於反訴起訴狀中以諸多篇幅敘述被告美商應材所擁有之系爭專利之申請過程、專利範圍之更正及舉發案等程序，主張被告美商應材據以聲請假處分之系爭專利具有重大瑕疵或無效云云。然關於系爭專利之效力、申請過程、更正之否准或舉發案是否有理由等等，皆應由專利專責機關智慧局審查，非反訴原告得自行評斷為無效或有重大瑕疵云云。況反訴原告雖對系爭專利提出舉發案，惟無論是智慧財產局、經濟部訴願委員會、台北高等行政法院及最高行政法院皆認

定反訴被告系爭專利有效故判令舉發不成立，反訴原告主張反訴被告明知系爭專利無效而提起本件訴訟，並無根據。

(2)是否核准系爭專利之取得及更正應依照我國專利法判斷，毋庸考量外國專利法規：

- ①專利權之保護皆採「屬地主義」原則，專利權人為取得專利權，須依申請專利國家之法律要件及程序進行，而各國主管機關審查專利之標準本有所不同。反訴原告一再聲稱被告美商應材系爭專利同一技術內容之相對應美國專利 US6,477,980 之申請過程曾多次限縮其專利範圍，因而反訴被告美商應材之系爭專利申請過程有重大瑕疵云云，顯忽略各國法律之差異性。
 - ②反訴原告主張我國加入世界貿易組織(WTO) 後，我國專利法須達 TRIPS 標準，故專利權利之要件及其權利保護存在國際化標準可資理解及遵循云云。惟 TRIPS 標準多為原則性規範，詳細法規內容仍有賴各國法規具體規定，因此符合 TRIPS 之規範並不影響各國法律主權及專利之屬地性。是故我國專利申請相關之程序與實體事項皆須遵循我國法律，不得認為系爭專利於美國之申請過程或專利範圍之更正等事項必然一體適用於我國系爭專利之申請程序上。
 - ③各國專利法規、審查程序及審查標準不同，同一發明在各國之申請專利範圍及其描述方式本須作適當之調整及因應。故被告美商應材美國專利 US6,477,980 之專利範圍在美國專利制度下所為之更正，並不當然適用於系爭專利依照我國專利法之取得及更正。況專利申請範圍應如何敘述為高度技術性之事項，專利申請人基於技術保護需求、商業目的、費用、時間及成本等等之不同考量，其專利申請範圍於不同國家可能傾向擴張或保守，此並無違反法令，且不涉及任何主觀惡意或濫用權利等意圖。關於專利申請案是否有任何先前技術存在或既存技術是否為與本件相關之先前技術而應於專利說明書內予以揭露，專利申請權人依法得為判斷與取捨。反訴原告主張系爭專利之母案遭美國專利主管機關由原先 40 項刪除成 18 項，故反訴被告美商應材「明知於我國核准在先之本案據爭專利範圍不合理地遠大於母國專利」、「反訴被告對據爭專利因審查不慎不當包含未經刪除之專利權利範圍知之甚詳」或「明知其表面上存在之專利有無效之原因」云云，皆係誤導法院之不實推測。
- (3)反訴被告美商應材依法循法院假處分及本案訴訟程序行使專利權，係保護其專利權之正當行為，不構成濫訴或濫用權利

①專利制度之本質，為國家賦與專利權人對其專利之利用享有「排他權」。專利法第 56 條明定專利權人專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等排他性之權利。專利法第 84 條並賦予專利權人排除侵害及防止侵害之請求權。是故專利權人依法本得循假處分或訴訟程序，請求司法機關排除侵害以保障其權利，此為正當且通常之保護權利方式。基於此，公平交易法第 45 條明文將依照專利法行使權利之正當行為排除於公平交易法適用之外，以尊重專利法所賦予之獨占權。

②反訴被告美商應材為保護系爭專利，已依法定程序於提起假處分及本件訴訟前先行委請司法院與行政院所共同指定之專業鑑定機構國立交通大學科技法律研究所（下稱「交通大學」），就反訴原告之系爭產品是否侵權進行鑑定分析。鑑定之結果顯示反訴原告之系爭產品確實落入美商應材之專利權範圍，反訴被告美商應材乃基於交通大學之侵害鑑定報告，委託律師對於反訴原告提起假處分及本件訴訟，反訴被告美商應材行使專利權之程序完全正當合法。

③反訴原告指稱被告美商應材公司於面臨舉發案之威脅後，竟不待任何答辯，立即自動申請變更系爭專利之權利範圍，顯見系爭專利具無效原因早在反訴被告美商應材公司預期之中云云，並非事實。反訴被告美商應材公司雖自行申請限縮系爭專利之範圍，使專利範圍更加明確，惟反訴原告之產品仍落入更正後之系爭專利範圍內，故相關更正對本件訴訟並無實質影響。反訴被告美商應材公司為避免爭議，已於本件訴訟程序中就反訴原告之系爭產品重新進行鑑定並確認無論反訴被告美商應材是否更正專利範圍，反訴原告產品侵害系爭專利確為事實，反訴被告美商應材公司採取法律行動完全正當合法。

4. 反訴被告據以提出假處分及本案訴訟之證據資料並無不實

①反訴被告所據以提出假處分及本案訴訟之交通大學鑑定報告，其憑據之鑑定資料確係由反訴原告所製作並用以向潛在之客戶介紹系爭產品之行銷資料，且反訴原告於假處分程序亦承認該等行銷資料為反訴原告所製作。關於此，反訴被告業已於 95 年 10 月 25 日之民事準備書(一) 狀及 96 年 1 月 5 日民事準備書(二) 狀詳為說明鑑定資料之來源及真正性。反訴原告主張鑑定報告所比對之資料根本非反訴原告系爭產品設計或疑經偽造云云，並非事實。

②反訴被告於假處分程序中所提出之「周星公司型錄」或「周

星資料編號 A、B、C」，兩者內容相同，僅編排方式相異，反訴原告明知此事實仍妄稱其為不同之證物、疑經偽造云云，實為故意混淆事實，不足採信。而反訴被告於 93 年 6 月 30 日向鈞院提起本案訴訟時，特別將「周星資料 A、B、C」，整併為一份證物，並將該資料透過韓文作業系統重新列印而得顯示全文，實與反訴被告於假處分程序中所提之證物相同。至於原證 4 交通大學鑑定報告第 68 頁圖式為反訴原告第五代機器、第 69 頁圖式則係反訴原告第四代機器，兩者圖示顯示為不同之機器設備乃理所當然，惟該二圖皆係指反訴原告之機器設備且皆係由反訴原告所製作，故反訴被告並未使用不實之資訊。

5. 反訴原告迄今並未提出任何計算式或證據證明反訴原告受有損害以及所受損害之金額為何，其請求損害賠償並無可採反訴原告雖主張反訴被告應賠償反訴原告 1000 萬元。然反訴原告迄今並未提出任何證據證明其因反訴被告對反訴原告提起假處分或本案訴訟而受有任何損害以及損害金額若干。反訴原告既未盡其舉證責任，鈞院自應駁回反訴原告之請求。
6. 反訴原告基於公平交易法及侵權行為之請求權已罹於 2 年時效

反訴被告並未違反公平交易法或構成侵權行為，如前開說明，有關反訴原告公平交易法及侵權行為之請求權無論有無成立，因該等請求權已罹於 2 年時效，仍應駁回反訴原告之反訴。謹說明如下：

(1) 關於公平交易法請求部分

關於公平交易法所定請求權之時效，公平交易法第 33 條規定：「本章所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自為行為時起，逾十年者亦同。」反訴被告係於 92 年 12 月 24 日聲請假處分(當時即已提出交通大學鑑定報告)並於 93 年 6 月 30 日提起本件訴訟。惟反訴原告係於 95 年 10 月 30 日始提起本件反訴主張反訴被告應依照公平交易法第 34 條將判決書內容刊登新聞紙，並於 96 年 2 月 5 日始追加請求反訴被告應依照公平交易法第 31 條賠償反訴原告新台幣 1000 萬元，故反訴原告本於公平交易法第 34 條及第 31 條規定之請求權，縱令成立，亦已罹於 2 年時效。

(2) 關於侵權行為請求部分

關於民法侵權行為請求權之時效，民法第 197 條第 2 項規定：「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。自有侵權行為

時起，逾十年者亦同。」反訴原告所主張反訴被告構成侵權行為之相關事實，反訴原告至遲於反訴被告提起本案訴訟時（93年6月30日）即已知悉，反訴原告直到98年5月26日民事準備(一)狀始主張侵權行為請求權，故其侵權行為損害賠償請求權縱令成立，亦已罹於2年時效。

7. 綜上所述，反訴被告顯無任何違反公平交易法之行為亦未構成侵權行為。請求駁回反訴原告之反訴，

三、反訴原告提起本件反訴之基礎事實有二，即

(一)、反訴被告明知專利無效而仍聲請假處分及提起本案訴訟。

(二)、反訴被告明知所謂「周星ABC」為內容不實資料，而仍據以提起本件訴訟。

四、本院判斷：

(一)、至反訴原告主張被告係獨占事業，明知專利無效，濫發專利警告函違反公平交易法行為，業經行政院公平交易委員會認反訴被告並非獨占事業，且無違反公平交易法行為，經被告英屬蓋曼群島商周星科技公司提起訴願、行政訴訟，均遭駁回，有最高行政法院98年判字第343號判決可參。

(二)、反訴被告是否有明知專利無效而仍聲請假處分及提起本案訴訟部分。

1. 反訴原告雖主張被告被告明知系爭專權有得撤銷之事由，仍聲請假處分及提起本件訴訟；至反訴被告則否認有反訴原告所主張之該事實，惟就反訴被告明知系爭專利權有得撤銷之事由仍聲請假處分及提起本件訴訟事實中「明知」部分，反訴原告在最後言詞辯論意旨狀中並未明確指出何證據可證明反訴被告明知，自難反訴原告此部分之主張為可採。

2. 反訴原告另曾主張反訴被告就系爭專利於聲請假分或起訴後，仍聲請更正專利申請範圍，應係明知系爭專利有得撤銷之事由始會聲請更正等語，惟依專利法第64條更正專利範圍，本係發明專利權人之權利，專利權人可依其專利之內容決定請更正之範圍，且該更正並不得超出專利權範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍，故尚難以反訴原告聲請假處分或提起本件訴訟後，仍更正專利範圍，即認反訴被告明知專利無效。

3. 況反訴原告英屬蓋曼群島商周星科技公司亦曾就系爭專利提出舉發案，第一次舉發案亦經行政程序判決舉發不成立確定，如前開說明，顯見系爭專利是否具有得撤銷原因，非反訴被告所明知。

4. 綜合前開說，反訴原告主張反訴被告明知專利無效而仍聲請

假處分及提起本案訴訟，自無可採。

(二)、反訴被告是否有明知所謂「周星 ABC」為內容不實資料，而仍據以提起本件訴訟部分：

反訴原告主張反訴被告明知所謂「周星 ABC」為內容不實資料，而仍據以提起本件訴訟主要係以反訴被告並未提出該資料提供者相關資料為憑，惟反訴原告並未舉證證明反訴被告明知所謂「周星 ABC」為內容不實之資料，反訴原告縱未說明該資料之來源，亦係該資料在假處分或本件訴訟程序中，法院是否採信該證據之問題，亦難僅因反訴被告拒絕說明該資料來源即認反訴被告「明知」「周星 ABC」為內容不實之資料，反訴原告此部分之主張亦無可採。

五、就本件反訴部分，反訴原告主張反訴被告明知專利無效而仍聲請假處分及提起本案訴訟；反訴被告明知所謂「周星 ABC」為內容不實資料，而仍據以提起本件訴訟，故違反公平交易法及構成侵權行為，反訴原告既不能證明有前開其所主張之事實存在，則反訴原告以前開公平交易法及侵權行為相關規定，請求反訴被告等應連帶負擔費用，將反訴判決書之摘要內容全部以「十全（即長 25 公分寬 30 點 5 公分之版面）」之規格刊載於中國時報、自由時報及聯合報第一版乙日；反訴被告等應連帶給付反訴原告 1 千萬元整及自反訴起訴狀送達之日起至清償日止按年息百分之 5 計算之利息，即無理由，應予駁回。其假執行之聲請，亦失所附麗，應併駁回之。

六、本件反訴部分事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法暨未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

七、結論：反訴原告之訴為無理由，依民事訴訟法第 78 條判決如主文。

中 華 民 國 99 年 12 月 31 日
民事第一庭 法 官 王銘勇

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 99 年 12 月 31 日

書記官 呂聖儀